PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-005137

(43) Date of publication of application: 12.01.2001

(51)Int.Cl.

G03C 1/498

G03C 1/76

(21)Application number: 11-178720

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

24.06.1999

(72)Inventor: KURAKI YASUO

(54) HEAT DEVELOPABLE IMAGE RECORDING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a heat developable image recording material which does not cause an unevenness in heat processing due to a defective conveyance in the handling of the heat developable photosensitive material by incorporating lubricant dispersed particles comprising a specified lubricant and a specified dispersant into the outermost layer on the image forming layer side of a substrate. SOLUTION: The heat developable image recording material is heat-developed at a temp. of $80-140^{\circ}$ C and contains lubricant dispersed particles comprising a lubricant of the formula (R1COO)pL(COOR2)q and a dispersant of the formula (R3)a-G-(D)d in the outermost layer on the image forming layer side of the substrate. In the formulae, R1-R3 are each a 1-60C optionally substituted alkyl or the like, L is a (p+q)-valent hydrocarbon which may contain O or S, (p) and (q) are each an integer of 0-6, $1 \le p+q \le 6$, G is a dito heptavalent combining group, D is (B)n-E, B is -CH2CH2O- or the like, (n) is an integer of 1-5, E is H, 1-8C optionally substituted alkyl or the like and (a) and (d) are each an integer of 1-6.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-5137 (P2001-5137A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全38 頁)

(21)出顧番号 特顧平11-178720 (71)出願人 000005201

 (22)出願日
 平成11年6月24日(1999.6.24)
 す奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 椋木 康雄 神奈川県南足柄市中紹210番地 富士写真

フイルム株式会社足柄研究所内

(74)代理人 100095843

弁理士 釜田 淳爾 (外2名)

Fターム(参考) 2H123 AB00 AB03 AB23 AB28 BA00

BA32 BA45 BA47 BA56 BB00 BB17 BC00 BC11 CB00 CB03

(54) 【発明の名称】 熱現像画像記録材料

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 熱現像感材の取扱い中に搬送不良による熱処理ムラを発生せず、取扱い中に傷が付きにくく、取り扱い時におけるゴミ付き故障や静電気トラブルがなく、熱現像後の時間経過における寸法変化が少なく、熱現像時にシワの発生がなく、しかも熱現像の前後の寸法変化の少ない熱現像画像記録材料の提供。

【解決手段】 支持体の一方に画像形成層と最外層を有し、80℃以上140℃以下の現像温度で熱現像処理が行われる熱現像画像記録材料において、最外層に下記一般式(1)で表される一種の滑り剤と一般式(2)で表わされる一種の分散剤からなる滑り剤分散粒子を含有することを特徴とする熱現像画像記録材料。

一般式 (1) $(R^1COO)_pL(COOR^2)_q$

例之(ず (n)CisHaiCOOCisHai(n)

一般式 (2) (R³)₈-G-(D)_d (R₂O+CH₂CH₂O)₁₀H

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体の少なくとも一方に画像形成層と最外層を有し、80℃以上140℃以下の現像温度で熱現像処理が行われる熱現像画像記録材料において、最外層に下記一般式(1)で表される少なくとも一種の滑り剤と一般式(2)で表わされる少なくとも一種の分散剤からなる滑り剤分散粒子を含有することを特徴とする熱現像画像記録材料。

一般式(1) (R^1COO)。 $L(COOR^2)$ 。 (式中、 R^1 および R^2 は、炭素数 $1\sim 60$ の置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基またはアリール基であり、pまたはqが 2以上である場合、複数存在する R^1 および R^2 は互いに同一でも相違していてもよい;Lは、酸素原子または硫黄原子を含んでいてもよいp+q価の炭化水素基であり、pおよびqは $0\sim 6$ の整数を表し、 $1\leq p+q\leq 6$ である)

一般式 (2) $(R^3)_a - G - (D)_d$

(式中、 R^3 は炭素数 $10\sim60$ の置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基またはアリール基である;Gは $2\sim7$ 価の連結基を示す;Dは、 $(B)_n-E$ であり、B は $-CH_2$ CH_2 O-、 $-CH_2$ CH_2 CH_2 CH_2 CH_3 O-、 $-CH_4$ CH_4 O-、 $-CH_4$ CH_5 O- 又は $-CH_6$ CH(OH) CH_5 O- を表わし、n は $1\sim50$ の整数である。ここで、E は、水素、炭素数 $1\sim80$ 置換もしくは無置換のアルキル基,アリール基,アルキルカルボニル基またはアリールカルボニル基を表わす; aおよびdはそれぞれ $1\sim6$ の整数を表す;複数存在する R^3 、D および E は互いに同一でも相違していてもよい。)

【請求項2】 滑り剤分散粒子が、25~99重量%の一般式(1)で表される少なくとも一種の滑り剤と、1~75重量%の一般式(2)で表される少なくとも一種の分散剤から作成されることを特徴とする請求項1に記載の熱現像画像記録材料。

【請求項3】 滑り剤分散粒子が、平均粒径が 0.005μ m以上 0.5μ m以下である分散物で塗布液に添加されることを特徴とする請求項1 または2 に記載の熱現像画像記録材料。

【請求項4】 滑り剤分散粒子の融点が50 \mathbb{C} 以上20 0 \mathbb{C} 以下であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

【請求項5】 滑り剤分散粒子が、一般式(1)で表される少なくとも一種の滑り剤と一般式(2)で表わされる少なくとも一種の分散剤とをその融点以上の温度で溶融混合し、その後に分散工程にて分散することによって作成されることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

【請求項6】 滑り剤分散粒子を含有する最外層の動摩擦係数が0.35以下0.05以上であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

【請求項7】 少なくとも一層に含フッ素系界面活性剤を有することを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

【請求項8】 支持体の少なくとも一面上に少なくとも一層の導電層を有し、その抵抗が 10^{12} Ω 以下であることを特徴とする請求項 $1\sim7$ のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

【請求項9】 支持体上に、有機銀塩、還元剤および感光性ハロゲン化銀を含む画像形成層を少なくとも1層有10 し、支持体の下塗り層として70~99.9重量%の塩化ビニリデン単量体の繰り返し単位と0.1~5重量%のカルボキシル基含有ビニル単量体の繰り返し単位とを含むポリマーを使用することを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

【請求項10】 支持体が二軸延伸したポリエステルであり、塩化ビニリデン共重合体を含有する下塗り層を塗設した後、130℃以上185℃以下の温度で熱処理を施されて製造されることを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載の熱現像画像記録材料。

20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は熱現像画像記録材料、特に写真製版用に用いられる熱現像画像記録材料に関し、スキャナー、イメージセッター用画像記録材料に関する。さらに詳しくは、本発明は、熱現像でフィルムの搬送性トラブルがなくかつ傷付き故障のない熱現像画像記録材料、さらに写真性能を悪化することのない帯電防止性に優れたカラー写真製版に適する熱現像画像記録材料、熱現像用のレントゲン感光材料及びマイクロ感光30 材料に関する。

[0002]

【従来の技術】写真感光材料の露光方法の一つに、原図 を走査し、その画像信号に基づいてハロゲン化銀写真感 光材料上に露光を行い、原図の画像に対応するネガ画像 もしくはポジ画像を形成するいわゆるスキャナー方式に よる画像形成方法が知られている。さらにスキャナーか らフィルムに出力した後、返し工程を経ずに直接刷版に 焼き付けるケースやソフトなビームプロファイルを有す るスキャナー光源に対しては超硬調な特性を有するスキ 40 ャナー感光材料が求められている。支持体上に感光層を 有し、画像露光することで画像形成を行う感光材料は、 数多く知られている。それらの中でも、環境保全や画像 形成手段が簡易にできるシステムとして、熱現像により 画像を形成する技術が挙げられる。近年写真製版分野に おいて環境保全、省スペースの観点から処理廃液の減量 が強く望まれている。そこで、レーザー・スキャナーま たはレーザー・イメージセッターにより効率的に露光さ せることができ、高解像度および鮮鋭さを有する鮮明な 黒色画像を形成することができる写真製版用途の感光性 50 熱現像材料に関する技術が必要とされている。これらの

感光性熱現像材料では、溶液系処理化学薬品の使用をなくし、より簡単で環境を損なわない熱現像処理システムを顧客に対して供給することができる。

【0003】熱現像により画像を形成する方法は、例え ば米国特許第3,152,904号、同3,457,075号、およびD. モーガン(Morgan)とB. シェリー(Shely)による「熱に よって処理される銀システム(Thermally Processed Silver Systems)」(イメージング・プロセッシーズ ・アンド・マテリアルズ (Imaging Processes and Mate rials) Neblette 第8版、スタージ(Sturge)、V. ウォ ールワース(Walworth)、A. シェップ(Shepp)編集、第 2頁、1969年)に記載されている。このような感光材料 は、還元可能な非感光性の銀源(例えば有機銀塩)、触 媒活性量の光触媒(例えばハロゲン化銀)、および銀の 還元剤を通常有機バインダーマトリックス中に分散した 状態で含有している。感光材料は常温で安定であるが、 露光後高温(例えば80℃以上)に加熱した場合に、還 元可能な銀源(酸化剤として機能する)と還元剤との間 の酸化還元反応を通じて銀を生成する。この酸化還元反 応は露光で発生した潜像の触媒作用によって促進され る。露光領域中の還元可能な銀塩の反応によって生成し た銀は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対照をな し、画像の形成がなされる。

【0004】従来からこのタイプの熱現像感光材料は知 られているが、これらの感光材料の多くは延伸製膜した ポリエステルが支持体として用いられており、高温(8) 0℃以上)で熱現像を施すと支持体の熱寸法変化(主に 熱収縮)により画像が変形してしまう不都合が生じてし まう。さらに画像形成層のバインダーも熱現像時に脱水 収縮と熱膨張が同時におこり、支持体の熱寸法変化挙動 と異なるためにフィルムにシワが発生し、重ね合わせて 使用するカラー印刷には不適切なフィルムしか得られな い。これらの熱現像に起因する寸法変化やシワを防止す る技術としては、支持体を延伸製膜する際に生じる内部 歪みを緩和させる種々の熱処理方法が開示されている。 特開平3-24936号、特開昭64-64833号、 特開平8-211547号、特開平3-97523号、 特開昭61-154829号、特開平3-97523 号、特開昭57-109946号等である。

【0005】又、カラー写真製版は、Y版、M版、C版、K版の4枚のフィルムを用いて行われ、これらの4版の露光/熱現像が同時に行われる場合は良いものの、しばしば、露光/熱現像が時間がズレで行われることがある。このような時には、各フィルムの熱現像処理後の経過時間が異なるために各フィルムの寸法が合わず、しばしば、色ズレの原因になることが多かった。どのような取り扱い状態でも、寸法安定性に優れた熱現像感光材料を提供する技術が望まれていた。さらに、フィルムの取り扱いは従来の湿式に比べ、その簡便性から今まで以上に過酷に取り扱われる。例えば、高速搬送での傷付き

であり、現像中でにおけるジャミングや搬送ローラーへ の巻き付きやムラの故障の原因となる。さらにまたは保 存中に感材の表面とバック面がくっ付く故障を発生す る。そして、静電気による帯電故障のゴミ付きとなり商 品価値を著しく低下させる。

[0.006]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこれら従来技術の問題点を解消することを解決すべき課題とした。即ち、本発明は、熱現像感材の取扱い中に搬送不良による 10 熱処理ムラを発生しない熱現像画像記録材料を提供することを解決すべき課題の一つとした。本発明はまた、取扱い中に傷の付きにくい熱現像画像記録材料を提供することを解決すべき課題の一つとした。本発明はさらに、取り扱い時におけるゴミ付き故障や静電気トラブルのない熱現像画像記録材料を提供することを解決すべき課題の一つとした。本発明はさらにまた、熱現像後の時間経過における寸法変化が少なく、熱現像時にシワの発生がなく、しかも熱現像の前後の寸法変化の少ない熱現像画像記録材料を提供することを解決すべき課題の一つとした。

[0007]

30

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題を 解決するために鋭意検討を重ねた結果、画像形成層側の 最外層に特定の化学構造で表される滑り剤と特定の構造 で表される分散剤からなる滑り剤分散粒子を含有させる ことによって、所望の効果を奏する優れた熱現像画像記 録材料を提供し得ることを見出し、本発明を提供するに 至った。即ち、本発明によれば、支持体の少なくとも一 方に画像形成層と最外層を有し、80℃以上140℃以 下の現像温度で熱現像処理が行われる熱現像画像記録材 料において、最外層に下記一般式(1)で表される少な くとも一種の滑り剤と一般式(2)で表わされる少なく とも一種の分散剤からなる滑り剤分散粒子を含有するこ とを特徴とする熱現像画像記録材料が提供される。 $(R^1COO)_PL(COOR^2)_q$ 一般式(1) (式中、 R^1 および R^2 は、炭素数 $1\sim60$ の置換もしく は無置換のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基ま たはアリール基であり、pまたはqが2以上である場 合、複数存在する R^1 および R^2 は互いに同一でも相違し ていてもよい;Lは、酸素原子または硫黄原子を含んで いてもよいp+q価の炭化水素基であり、pおよびqは $0 \sim 6$ の整数を表し、 $1 \leq p + q \leq 6$ である) $(R^3)_a - G - (D)_d$ 一般式(2) (式中、R³は炭素数10~60の置換もしくは無置換 のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基またはアリ ール基である;Gは2~7価の連結基を示す;Dは、 (CH₃)CH₂O-又は-CH₂CH(OH)CH₂O-を表わし、nは1~5

0の整数である。ここで、Eは、水素、炭素数1~8の

置換もしくは無置換のアルキル基、アリール基、アルキ

ルカルボニル基またはアリールカルボニル基を表わす; aおよびdはそれぞれ $1 \sim 6$ の整数を表す;複数存在する R^3 、 Dおよび E は互いに同一でも相違していてもよい。)

【0008】本発明の一態様では、滑り剤分散粒子は、 25~99重量%の一般式(1)で表される少なくとも 一種の滑り剤と、1~75重量%の一般式(2)で表さ れる少なくとも一種の分散剤から作成される。本発明の 一態様では、滑り剤分散粒子が、平均粒径が0.005 μ m以上0. 5 μ m以下である分散物で塗布液に添加さ れる。本発明の一態様では、滑り剤分散粒子の融点は5 0℃以上200℃以下である。本発明の一態様では、滑 り削分散粒子は、一般式(1)で表される少なくとも一 種の滑り剤と一般式(2)で表わされる少なくとも一種 の分散剤とをその融点以上の温度で溶融混合し、その後 に分散工程にて分散することによって作成される。本発 明の一態様では、滑り剤分散粒子を含有する最外層の動 摩擦係数が0.35以下0.05以上である。本発明の 一態様では、少なくとも一層に含フッ素系界面活性剤を 有する。本発明の一態様では、支持体の少なくとも一面 上に少なくとも一層の導電層を有し、その抵抗が10" Ω以下である。

【0009】本発明の一態様では、有機銀塩、還元剤および感光性ハロゲン化銀を含む画像形成層を少なくとも1層有し、支持体の下塗り層として70~99.9重量%の塩化ビニリデン単量体の繰り返し単位と0.1~5重量%のカルボキシル基含有ビニル単量体の繰り返し単位とを含むポリマーが使用される。本発明の一態様では、支持体が二軸延伸したポリエステルであり、塩化ビニリデン共重合体を含有する下塗り層を塗設した後、130℃以上185℃以下の温度で熱処理を施されて製造される。

[0010]

a(G) b (D-E)d

【発明の実施の形態】以下に、本発明の熱現像画像記録材料の実施態様および実施方法について詳細に説明する。本発明の熱現像画像記録材料は、画像形成層側の最外層が下記一般式(1)で表される少なくとも一種の滑り剤と一般式(2)で表わされる少なくとも一種の分散剤からなる滑り剤分散粒子を含有することを特徴とする。

一般式 (1) (R^1COO)。L ($COOR^2$)。 (式中、 R^1 および R^2 は、炭素数 $1\sim 60$ の置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基またはアリール基であり、pまたはqが 2以上である場合、複数存在する R^1 および R^2 は互いに同一でも相違していてもよい;L は、酸素原子または硫黄原子を含んでいてもよい;L は、酸素原子または硫黄原子を含んでいてもよい p+q 価の炭化水素基であり、pおよび qは $0\sim 6$ の整数を表し、 $1\leq p+q\leq 6$ である)一般式 (2) (R^3)a (G) b - (D) d-E又は (R^3)

(式中、R³は炭素数10~60の置換もしくは無置換 のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基またはアリ ール基である; Gは2~7価の連結基を示す; Dは、一 般式- (B-O) n-である。ここでBは-CH2 CH2-、-C H₂ CH₂ CH₂ -、-CH(CH₃) CH₂ -又は-CH₂ CH(OH) CH₂ -を表わし、 nは1~50の整数である。ここで、Eは、水素、炭素 数1~8の置換もしくは無置換のアルキル基、アリール 基、アルキルカルボニル基またはアリールカルボニル基 を表わす; a、b、dはそれぞれ1~6の整数を表す。) 【0011】先ず、一般式(1)で表される滑り剤につ いて説明する。一般式(1)で表される化合物における 総炭素数は特に限定されないが、一般的には20以上が 好ましく、30以上がさらに好ましく、例えば40~1 00、さらに50~100、特には50~80である。 R¹とR²の定義におけるアルキル基、アルケニル基、ア ラルキル基またはアリール基が有していてもよい置換基 の例としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ 基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、アルコキシカルボニル基、アリー ルオキシカルボニル基、アミノ基、アシルアミノ基、ス ルホニルアミノ基、ウレイド基、カルバモイル基、スル ファモイル基、アシル基、スルホニル基、スルフィニル 基、アリール基およびアルキル基を挙げることができ る。これらの基はさらに置換基を有してもよい。好まし い置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アル コキシ基、アルキルチオ基、アルコキシカルボニル基、 アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アシル基および アルキル基である。ハロゲン原子としては、フッ素原 子、塩素原子が好ましい。アルコキシ基、アルキルチオ 基、アルコキシカルボニル基におけるアルキル成分は後 述するR²のアルキル基と同じである。アシルアミノ 基、スルホニルアミノ基のアミノ基はN置換アミノ基で あってもよく、置換基はアルキル基が好ましい。アシル アミノ基、アシル基のカルボニル基およびスルホニルア ミノ基のスルホニル基に結合する基はアルキル基、アリ

ール基であるが、上記アルキル基が好ましい。
【0012】R¹およびR²は、炭素数1~60、好ましくは炭素数1~40、より好ましくは炭素数10~40
の置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、ア
40 ラルキル基またはアリール基であり、これらアルキル基、アルケニル基、アラルキル基は、直鎖でも分岐鎖でも環状構造を含むものでもよく、これらが混合したものでもよい。好ましいR¹およびR²の例としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、オクチル、 t ーオクチル、ドデシル、テトラデシル、ヘキサデシル、2ーヘキシルデシル、オクタデシル、Cn H2n1 (n は 2 0~60を表す)、エイコシル、ドコサニル、メリシニル、オクテニル、ミリストレイル、オレイル、エルシル、フェニル、ナフチル、ベンジル、ノニルフェニル、ジペンチのルフェニル、シクロヘキシル基およびこれらの上記置換

*【0014】上記一般式(1)で表される化合物は、合 成物であっても天然物であってもよい。天然物、あるい

は合成物であっても天然物の高級脂肪酸やアルコールを 原料とした合成化合物は、炭素数の異なるものや直鎖と

分岐のものを含み、これらの混合物となるが、これらの

混合物を使用することは何等差し支えない。組成の品質

安定性の観点では合成物が好ましい。以下に好ましい一

般式(1)で表される化合物の具体例を示す。

基を有する基等を挙げることができる。

【OO13】Lは、酸素原子または硫黄原子を含んでい てもよい p + q 価の炭化水素基である。炭化水素基の炭 素数は特に限定されないが、好ましくは1~60、より 好ましくは $1\sim40$ 、さらに好ましくは $10\sim40$ であ る。p+q 価の炭化水素基における「p+q 価」とは炭 化水素中の p+q個の水素原子が除かれて、そこに p個 のR¹COO-基とq個のR²OCO-基が結合すること を示す。pおよびqは $0\sim6$ の整数を表し、 $1\leq p+q$ ≤ 6 であり、好ましくは $1 \leq p + q \leq 4$ である。また、 pまたはqのいずれかがOである場合が好ましい。

[0015] 【化1】 10 (LB-2) $(n)C_{15}H_{31}COOC_{24}H_{49}(n)$ (LB-1) $(n)C_{15}H_{31}COOC_{16}H_{33}(n)$ (LB-3) $(n)C_{17}H_{35}COOC_{18}H_{37}(n)$ (LB-4) $(n)C_{17}H_{35}COOC_{32}H_{65}(n)$ (LB-5) $(iso)C_{17}H_{35}COOC_{36}H_{73}(iso)$ (LB-6) $(n)C_{17}H_{35}COOC_{40}H_{81}(n)$ $(LB-7) \quad (n)C_6H_{13}CH(OH)C_{10}H_{20}COOC_{40}H_{81}(n) \quad (LB-8) \quad (n)C_{21}H_{43}COOC_{16}H_{33}(n)$ (LB-9) $(n)C_{21}H_{43}COOC_{22}H_{45}(n)$ (LB-10) (n)C₂₃H₄₇COOC₂₀H₄₁(n) (LB-12) (n)C₂₅H₅₁COOC₃₀H₆₁(n) (LB-11) $(n)C_{23}H_{47}COOC_{32}H_{65}(n)$ (LB-14) $(n)C_{50}H_{101}COOC_{50}H_{101}(n)$ (LB-13) $(n)C_{35}H_{71}COOC_{20}H_{41}(n)$ (LB-15) $(n)C_{18}H_{37}OOC-(CH_2)_6COOC_{18}H_{37}(n)$ $(LB-17)((n)C_{15}H_{31}COOCH_2)_3CCH_3$ (CH₂)₃COOC₄₀H₈₁(n)(LB-19) (n)C₂₃H₄₇COO-CH₂ $CH_2)_3COOC_{40}H_{81}(n)$ (n)C23H47COO-CH (LB-18) (n)C₁₅H₃₁COO-CH₂ (n)C23H47COO-CH2 (n)C₁₅H₃₁COO-CH COOC₁₈H₃₇(n) (LB-22) (n)C₁₈H₃₇OOC (n)C₁₅H₃₁COO-CH₂ $COOC_{18}H_{37}(n)$ (LB-20) (n) $C_{17}H_{35}COO-C \equiv \{CH_2OCOC_{17}H_{35}(n)\}_3$ COOC24H49(n) (LB-21) COOC₂₄H₄₉(n) (n)C24H49OOC (LB-24) $(n)C_{50}H_{101}COOC_8F_{17}(n)$ $COOC_{32}H_{65}(n)$ (LB-23) (LB-25) (n)C₈F₁₇COOC₃₀H₆₁(n) COOC₃₂H₆₅(n) (LB-26) (n)C₂₇H₅₅COOCH₂CH₂C₈F₁₇(n) (LB-27) (n)C₃₀H₆₁OOC(CH₂)₁₈COOCH₂CH₂C₈F₁₇

【0016】これらの化合物は、例えば、特開昭58-90633号に一部記載がある。上記化合物に加え、天 然物の例としてモンタン酸エステル、カルナウバワック ス、オレオストックなども加えることができる。

て説明する。本発明では、R³は炭素数10~60の置 換もしくは無置換の直鎖、分岐、環状を含むアルキル 基、アルケニル基、アラルキル基および置換もしくは無 置換のアリール基である。好ましいR³の例としてはC₈ 【0017】次に一般式(2)で表される分散剤につい 50 H_{2grl} (gは12~60の整数を表す)、エイコシル、

ドコサニルである。さらには、ドデシル、ミリスチル、 セチル、ステアリル、オレイル、エイコシル、ドコサシ ル、トリアコンタシル、テトラコンタシル、ヘプタコン タシル、ジノニルフェニル、ジドデシルフェニル、テト ラデシルフェニル、トリペンチルフェニル、ドデシルナ フチルなどである。Dは、一般式-(B)n -Eのポリオキシ アルキレン基を表す。ここで B は-CH₂ CH₂ O-、-CH₂ CH₂ CH 2 O-、-CH(CH2)CH2 O-又は-CH2 CH(OH)CH2 O-を表わし、nは 1~50の数である。Bとして好ましいのは-CH₂CH₂O-であり、好ましいnは5~30の整数である。又、Eは 10 水素、置換または無置換の炭素数1~8のアルキル基, アリール基、アルキルカルボニル基またはアリールカル ボニル基を表わす。アルキル基としては、好ましくはメ チル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル、シクロヘ キシルであり、特に好ましいのはメチル、エチル、プロ ピルである。アルキルカルボニル基としては、好ましく はアセチル、プロピオニル、ブチロイル、ピバロイル、 シクロヘキサンカルボニルであり、特に好ましいのはア セチルである。アリール基としてはフェニル基が、また*

*アリールカルボニル基としてはベンゾイル基を挙げられ る。Eで特に好ましいのは、水素、メチル、メチル、プ ロピル、アセチル、プロピオニル、ベンゾイルである。 【0018】Gは2価~7価、好ましくは2~5価、よ り好ましくは2価~4価、さらに好ましくは2価または 3価の連結基または単結合を表わし、好ましくはアルキ レン基、アリーレン基又はそれらの複合基を表わし、こ れは酸素、エステル基、硫黄、アミド基、スルホニル 基、硫黄の如き異種原子で中断された二価の置換、無置 換の連結基であっても良い。特に好ましくは酸素、エス テル基、アミド基である。aおよびdはそれぞれ1~6 の整数を表わす。なお、一般式(2)で表される分散剤 は、水系での溶解性が小さいことが望ましく、たとえば 水への溶解性が0.5重量%以下(25℃)が好まし く、さらに好ましいのは0.1重量%以下である。以下 に一般式(2)の具体的化合物例を挙げるがこれらに限 定されるものではない。

[0019] 【化2】

WA-2 $C_{40}H_{81}O + CH_2CH_2O + CH_2O + CH_2CH_2O + CH_2O +$

WA-3 $C_{50}H_{101}O + CH_2CH_2O + H_3$

WA-4 $C_{50}H_{101}O + CH_2CH_2O \rightarrow 30$ H

WA-5 $C_{40}H_{80}O + CH_2CH_2O + COCH_3$

WA-6 $C_{40}H_{80}O + CH_2CH_2O \rightarrow 20 COC_6H_5$

WA-7 $C_{39}H_{79}COO (-CH_2CH_2O)_{15}H$

WA-8 $C_{39}H_{79}COO + CH_2CH_2O \rightarrow 20$ CH_3

WA-9 C₄₀H₈₁O ← CH-CH₂O → (CH₂CH₂O → 120 H) CH₃

WA-10 $C_{40}H_{81}O$ (-CHCH₂O)₃ (-CH₂CHCH₂O)₁₀H CH₃ OH

₩A-11 C₄₀H₈₁O+CH-CH₂O)₃+(CH₂CHCH₂O)₃+(CH₂CH₂O)₁₀ H CH₃ OH

WA-12 C₁₈H₃₃O+CH₂CH₂O+12 H

 CH_3 WA-13 $C_{29}H_{59}CON+CH_2CH_2O)_{15}H$

WA-14
$$C_{29}H_{59}CON$$
 $<$ ($CH_2CH_2O\frac{*}{)10}H$ ($CH_2CH_2O\frac{}{)10}H$

$$C_9H_{19}$$
 $O+CH_2CH_2O+CH_2$

$$WA-16 \quad C_5H_{11} \longrightarrow C_5H_{11}$$

$$C_5H_{11}$$

$$C_5H_{11}$$

WA-17
$$C_{39}H_{79}CON$$
 (CH₂CH₂O) $\frac{}{x}$ H x+y=20 (CH₂CH₂O) $\frac{}{y}$ H

WA-18
$$C_{12}H_{25}$$
 SO₂N $(CH_2CH_2O)_{x}H$ $x+y=12$ $(CH_2CH_2O)_{y}H$

WA-19
$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{20}$$

【0021】本発明では、一般式(1)の滑り剤と一般 式(2)の分散剤からなる分散粒子(以下、本発明で用 いる滑り剤分散粒子とも称する)に加え、公知の他の滑 り剤と併用することもできる。公知の滑り剤として好ま しいものは、一般式(1)で表される化合物に類似す る、例えば、米国特許第4,275,146号に記載の 高級脂肪族アミド類、米国特許第3,933,516号 に記載の高級脂肪酸もしくはその金属塩類、その他高級 アルコールおよびその誘導体類、ポリエチレンワック ス、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワック ス、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル化合 物等を挙げることができる。また、天然物の油脂、ワッ クス、オイル、例えば、蜜蝋なども併用することができ る。さらに、併用できる好ましい公知の滑り剤として、 市販または合成によって入手可能なシリコーン系化合物 を挙げることができる。シリコーン系化合物にあっても ポリオルガノシロキサン類が好ましい。これらの水溶液 での利用に当たっては分散体の形で添加させることがこ のましい。

【0022】本発明で用いる滑り剤分散粒子は、分散物 の形で滑り剤層に添加されるが、その溶媒としては水が 好ましいがこれに限定されるものではない。例えば通常 の有機溶媒を適宜選択し、分散時に使用することができ る。例えば、ケトン類(アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサノンな 40 ど)、アルコール類(炭素数1~8の低級アルコール、 例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプ ロピルアルコール、ブチルアルコール、ヘキシルアルコ ール、オクチルアルコールなど)、グリコール誘導体類 (セロソルブ、エチレングリコールジエチルエーテル、 プロピレングリコールモノメチルエーテルなど)、炭素 数1~5の低級脂肪酸エステル類(酢酸エチル、酢酸ブ チル、プロピオン酸エチルなど)、ハロアルカン類(メ チレンジクロライド、エチレンジクロライド、トリクレ ン、トリクロロメタン、トリクロロエタン、四塩化炭素 50 など)、炭化水素類(オクタン、ソルベントナフサ、テ

50

レピン油、石油エーテル、シンナー、石油ベンジン、ベンゼン、トルエン、キシレンなど)、フェノール類(フェノール、レゾルシノールなど)、エーテル類(テトラヒドロフラン、ジオキサンなど)、リン酸エステル類(トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリブチルホスフェートなど)、アミド系のDMFその他DMSOなどを挙げることができる。好ましくはアルコール類、ケトン類、グリコール誘導体類、低級脂肪酸エステル類、ハロアルカン類、炭化水素類である。特に、水を混合使用する溶媒系においては、水と均一溶媒となるアルコール類、ケトン類、グリコール誘導体類の中から選ばれる溶媒であり、水不使用の場合の溶媒としては炭化水素類、ケトン類、低級脂肪酸エステル類、ハロアルカン類の使用が好ましい。

13

【0023】これらにより塗布液中での滑り剤の分散物 の安定性、塗布性、得られる塗膜の平滑性、感材屑やゴ ミ等の付着防止、現像処理時のハジキ改良、耐傷性に優 れるものである。なお、上記の有機溶媒は、同一もしく は異なる種類の溶媒と2種以上を混合して用いてもよ い。本発明では、水と有機溶媒の混合溶媒系の均一溶液 もしくは滑り剤の微細分散物として供給して塗布液とす る。微細分散物は公知の分散技術、例えば、機械的な剪 断力による分散、超音波分散、2液混合による析出法な どにより得られる。分散物としては、平均粒径2.0μ m以下、好ましくは1. 0μm以下、さらに好ましくは 0. 5 μ m以下 0. 0 0 5 μ m以上である。平均粒径を 0. 005 μ m以下にするためには、多量の分散剤を使 用することが必要になるが、これは写真性に悪影響を及 ぼす可能性がある。なお、水との混合溶媒の場合は、水 が 5 0 Vol %以上であることが好ましい。

【0024】次に、本発明で用いる滑り剤分散粒子につ いて更に詳細に記述する。本発明においては、一般式 (1) の滑り剤と一般式(2) の分散剤からなる滑り剤 分散粒子における両成分の構成比は特に限定されない が、25~99重量%の滑り剤と1~75重量%の分散 剤から作成される滑り剤分散粒子を使用することが好ま しい。これは、一般式(1)の滑り剤の含有量が多いほ どその滑り剤分散粒子としての特性を最外層で発現する ためである。したがって滑り剤分散粒子における一般式 (2) の分散剤はできるだけその含有比が小さい方が好 ましい。本発明で用いる滑り剤分散粒子は、予め分散さ れる前にその化合物の融点の高いほうよりも更に高温度 で混合され、いわゆる溶融混合することが好ましい。そ して、分散媒となる溶剤を同様に高温に加温しておき、 この中に溶融混合物を添加し各種の分散方法にて微細分 散化すればよい。なお、溶融混合物中に加温した溶剤を 添加して分散・粒子化することも好ましい。また滑り剤 または分散剤を溶解する非水系有機溶剤にこれらを溶解 したのち、水の中で他の水溶解性の界面活性剤を利用し て微細分散し、そのまま滑り剤の分散粒子として最外層 に添加してもよく、例えば非水系有機溶媒として酢酸エチルなどが好ましい。さらに有機溶剤を分散後に除去して滑り剤粒子分散物として利用することも有用である。この場合の優位点として、一般式(1)および一般式(2)の化合物の融点が100℃以上でも、低温度で有機溶剤中で溶解混合することができ、水系での高融点滑り剤分散粒子を作成できることである。ここで、一般式(1)および一般式(2)の融点は特に大きな制約を受けないが、傷付き特性に対して有効な融点としては、50℃以上200℃以下、さらに60℃以上が好ましく、特に80℃以上150℃以下が好ましい。溶剤としては、本発明の熱現像画像記録材料の作成にあたって環境にやさしい観点で、水が最も好ましい。したがって、融点80℃の一般式(1)の滑り剤を使用する場合は、水の温度を80℃以上として分散する必要がある。

【0025】本発明では、画像形成層側の最外層に、滑り剤分散粒子を少なくとも1種含有する。その場合、一般式(1)で表される滑り剤は2種以上を、例えば一般式(1)で表わされる化合物を2種以上、あるいは一般式(1)で表わされる化合物とそれ以外の滑り剤との組み合せ使用することができる。滑り剤分散粒子の塗設量は2~200g/㎡の範囲である。好ましくは5~100g/㎡であり、さらに好ましくは5~50g/㎡の範囲である。一般式(1)の滑り剤と一般式(2)の分散剤からなる滑り剤分散粒子と、それ以外の滑り剤を併用する場合においても全塗設量は上記の範囲である。なお、一般式(1)で表される化合物とそれ以外の滑り剤の併用にあっては、一般式(1)で表される化合物は全滑り剤の50重量%以上が望ましい。特に70重量%以上が好ましい。

【0026】本発明で用いる滑り剤分散粒子を含有する 最外層には、必要に応じてバインダーを使用してもよ い。バインダーとしては、公知の化合物、例えば、各種 ゼラチン類(アルカリ処理、酸処理、酵素処理、改質 (フタル化、コハク化、トリメリト化など)、変性、特 別な分子量分布等のゼラチンなど)、置換もしくは無置 換のセルロース類、天然物のアラビアゴム、デキストラ ンなどの親水性バインダーや通常の有機溶媒に可溶で現 像処理液など水に全くまたは殆んど不溶、かつ、フィル ム形成性を有する疎水性バインダー、例えば、ポリスチ レン、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニリデ ン、ポリアクリロニトリル、ポリ酢酸ビニルなどのホモ もしくはコポリマー、セルロースジアセテート、セルロ ーストリアセテート、エチルセルロース、セルロースナ イトレート、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロー スプロピオネートなどのセルロース誘導体、さらにポリ ビニルアセタール、ポリビニルベンザール、ポリビニル ホルマールなどのアセタール類などが挙げられる。これ らは2種以上を混合使用してもよい。

【0027】本発明では、親水性バインダーとしてはゼ

ラチン類、置換もしくは無置換のセルロース誘導体、特 に置換アルキルセルロース類が、疎水性バインダーとし てはセルロース誘導体の使用が好ましい。特にヒドロキ シアルキル(アルキル基は炭素数が1~5)セルロース 類、セルロースジアセテートの使用が好ましく、ヒドロ キシアルキル (炭素数が2~4) セルロースの使用が好 ましい。さらに本発明においては、滑り剤分散粒子を有 する最外層のバインダーとして、水不溶な疎水性ポリマ ーが微細な粒子として水溶性の分散媒中に分散したバイ ンダーも好ましい。そして、水系での疎水性バインダー 10 であるラテックスが特に好ましい。ラテックスは、分散 状態としてはポリマーが分散媒中に乳化されているも の、乳化重合されたもの、ミセル分散されたもの、ある いはポリマー分子中に部分的に親水的な構造を持ち分子 鎖自身が分子状分散したものなどいずれでもよい。なお 本発明に好ましく用いるポリマーバインダーについては 「合成樹脂エマルジョン(奥田平、稲垣寛編集、高分子 刊行会発行(1978))」、「合成ラテックスの応用(杉村孝 明、片岡靖男、鈴木聡一、笠原啓司編集、高分子刊行会 発行(1993))」、「合成ラテックスの化学(室井宗一著、 高分子刊行会発行(1970))」などに記載されている。分 散粒子の平均粒径は1~5000nm、より好ましくは5~1000 nm程度の範囲が好ましい。分散粒子の粒径分布に関して は特に制限はなく、広い粒径分布を持つものでも単分散 の粒径分布を持つものでもよい。ポリマーバインダーと しては通常の均一構造のポリマーのラテックス以外、い わゆるコア/シェル型のポリマーのラテックスでもよ い。この場合コアとシェルはガラス転移温度を変えると 好ましい場合がある。

15

【0028】本発明においてバインダーとして用いるポ リマーラテックスのポリマーのガラス転移温度(Tg) は種々の機器と接触するために膜強度、接着故障防止の 観点から25℃~100℃のガラス転移温度が特に好ま しい。ポリマーラテックスの最低造膜温度(MFT)は-3 0℃~90℃、より好ましくは0℃~70℃程度が好ま しい。最低造膜温度をコントロールするために造膜助剤 を添加してもよい。造膜助剤は一時可塑剤ともよばれポ リマーラテックスの最低造膜温度を低下させる有機化合 物(通常有機溶剤)で、例えば前述の「合成ラテックスの 化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(1970))」に記載さ れている。ポリマーラテックスに用いられるポリマー種 としてはアクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル 樹脂、ポリウレタン樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹 脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリオレフィン樹脂、または これらの共重合体などがある。ポリマーとしては直鎖の ポリマーでも枝分かれしたポリマーでも、また架橋され たポリマーでも良い。またポリマーとしては単一のモノ マーが重合したいわゆるホモポリマーでも良いし、二種 以上のモノマーが重合したコポリマーでも良い。コポリ マーの場合はランダムコポリマーでもブロックコポリマ ーでも良い。ポリマーの分子量は重量平均分子量で5000~1000000、好ましくは10000~100000で100000程度が好ましい。分子量が小さすぎるものはバインダーとしての力学強度が不十分であり、大きすぎるものは造膜性が悪く好ましくない。

【0029】本発明の熱現像画像記録材料のバインダー として用いられるポリマーラテックスの具体例としては 以下のようなものがある。メチルメタクリレート/エチ ルメタクリレート/メタクリル酸コポリマー、メチルメ タクリレート/2-エチルヘキシルアクリレート/ヒド ロキシエチルメタクリレート/スチレン/アクリル酸コ ポリマー、スチレン/ブタジエン/アクリル酸コポリマ ー、スチレン/ブタジエン/ジビニルベンゼン/メタク リル酸コポリマー、メチルメタクリレート/塩化ビニル /アクリル酸コポリマー、塩化ビニリデン/エチルアク リレート/アクリロニトリル/メタクリル酸コポリマー など。またこのようなポリマーは市販もされていて、以 下のようなポリマーが利用できる。例えばアクリル樹脂 の例として、セビアンA-4635,46583、4601(以上ダイセ ル化学工業(株)製)、Nipol Lx811、814、821、820、8 57、857x2(以上日本ゼオン(株)製)、VONCORT R3340、 R3360、R3370、4280、2830、2210(以上大日本インキ化 学 (株) 製)、ジュリマーET-410、530、SEK101-SEK30 1、FC30、FC35(以上日本純薬(株)製)、ポリゾールF 410、AM200、AP50 (以上昭和高分子(株)製)など、ポ リエステル樹脂としては、FINETEX ES650、611、675、8 50(以上大日本インキ化学(株)製)、WD-size、WMS(以 上イーストマンケミカル製)など、ポリウレタン樹脂と してはHYDRAN AP10、20、30、40、VONDIC 1320NS(以上 大日本インキ化学 (株) 製)など、ゴム系樹脂としてはL ACSTAR 7310K、3307B、4700H、7132C、LQ-618-1(以上大 日本インキ化学(株) 製)、Nipol Lx416、410、430、43 5、2507(以上日本ゼオン(株)製)など、塩化ビニル樹 脂としてはNipol G351、G576(以上日本ゼオン (株) 製) など、塩化ビニリデン樹脂としてはL502、L513(以上旭 化成工業(株)製)、アロンD7020、D5040、D5071(以上 東亜合成(株)製)など、オレフィン樹脂としてはケミ パールS120、SA100(以上三井石油化学(株)製)などを 挙げることができる。これらポリマーは単独で用いても よいし、必要に応じて二種以上ブレンドして用いても良

【0030】ポリマーラテックスのうちバインダーとしては、アクリル系、スチレン系、アクリル/スチレン系、塩化ビニル系、塩化ビニリデン系のポリマーラテックスが好ましく用いられる。具体的にはアクリル樹脂系のVONCORT R3370、4280、NipolLx857、メチルメタクリレート/2-エチルヘキシルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/スチレン/アクリル酸コポリマー、塩化ビニル樹脂のNipol G576、塩化ビニリデン樹脂のアロンD5071が好ましく用いられる。また、スチレン

/ブタジエン系のポリマーラテックスが好ましく用いられ、具体的にはゴム系樹脂のLACSTAR3307B、Nipol Lx43 0、435が好ましく用いられる。バインダーには必要に応じて全バインダーの25wt%以下の範囲でポリビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの親水性ポリマーを添加してもよい。さらに好ましくは、親水性ポリマーの添加量は最外層の全バインダーの15wt%以下が好ましい。

17

【0031】本発明の熱現像画像記録材料の最外層用の 10 全バインダー量は $0.1 \sim 10.0 \text{ g/m}^2$ 、より好まし くは $0.2\sim5.0g/m^2$ の範囲が好ましい。親水性バ インダーの使用に際しては、硬化剤を用いて水不溶もし くは難溶性にすることが望ましい。各種ゼラチン類の場 合は、公知の硬化剤を使用することができる。これら は、例えば、前記RD307105、第X章の文献に記 載されている化合物を使用することができる。ヒドロキ シアルキルセルロース類については、イソシアネート基 を2つ以上有する多官能イソシアネート化合物の使用が 好ましい。この様な硬化剤を使用することによって高分 子量化し、親水性を減じて現像処理液等水に不溶もしく は難溶性となり、フィルム形成性を賦与することができ る。最外層のバインダー使用量としては、塗設量が8g $/n^2$ 以下が望ましく、さらにが $6g/n^2$ 好ましい。最も 好ましいのは $5g/m^2$ 以下 $0.5g/m^2$ 以上である。 滑り剤含有層には、必要に応じてマット剤、塗布助剤、 濡れ剤などを含有してもよい。

【0032】滑り剤含有層の塗布は、公知の塗布方式、 例えば、エアードクター、ブレード、エアナイフ、スク イズ、含浸、リバースロール、トランスファーロール、 グラビア、キス、キャスト、スプレイ、ディップ、バ ー、エクストリュージョン等の塗布方式を利用して塗設 することができる。滑り剤分散粒子を含有する最外層の 滑り性は、動摩擦係数が0.35以下0.05以上が好 ましく更に好ましくは0.3以下であり、特に好ましく は0.25以下である。なお、動摩擦係数を0.05以 上としたのは、それより小さくするのは製造上安定に作 るのが困難だからである。ここで動摩擦係数の評価にあ たっては、25℃、60%RHの環境下で、100gの荷 重をかけた直径5mmのステンレス硬球を60mm/秒 のスピードで、滑り剤を含有する最外層表面との動摩擦 を測定したものである。乾燥温度は写真性、膜質などの 特性に影響を与えなければ特に限定はなく、例えば25 ~100℃の範囲で実施される。この場合、融点の低い 滑り剤分散粒子を用いた場合は、それよりも高い乾燥温 度で一度溶解し冷却により再度固化することがある。こ、 の現象をヘイズ低下の目的で積極的に利用することも行 われる。

【0033】本発明の好ましい態様では、最外層にフッ素含有界面活性剤を含有する。以下、本発明で好ましく用いられるフッ素含有界面活性剤について説明する。フッ素系界面活性剤はその特異な特性から好ましく用いられ、特に少量添加で塗布液の表面張力を低下させ塗布性能に優れ面状も良好であること、更にフッ素基による帯電列上で負帯電性を示すことから帯電防止に利用できる点である。本発明に好ましく使用されるフッ素含有界面活性剤は下記一般式(3)で表される。

一般式(3) R f - A - X 式中R f は少なくとも3個、好ましくは7個以上のフッ素原子を含有する部分フッ素化又は全フッ素化された置換、無置換のアルキル基、アルケニル基もしくはアリール基を表わす。Aは二価の連結基または単結合を表わし、Xは水溶性基を表わす。Aは、好ましくはアルキレン基、アリーレン基又はそれらの複合基を表わし、これは酸素、エステル基、アミド基、スルホニル基、硫黄の如き異種原子で中断された二価の置換、無置換の連結基であっても良い。

【0034】Xは親水性基であり、例えば一般式-(T-0) j -Ru のポリオキシアルキレン基(ここで T は-CH2 C H2-、-CH2 CH2 CH2 - 又は-CH2 CH(OH) CH2 - を表わし、 i はポ リオキシアルキレン基の平均重合度を表わし、1~50 の数である。又Ruは置換、無置換のアルキル基、アリ ール基を表わす) で表わされるノニオン基、親水性ベタ イン基、例えば - +N(R⁵)(R⁶)-AIK-COO - 及び - +N (R⁵)(R⁶)-AIK-SO₃ - (式中AIKは炭素数1~5の低 級アルキレン基、例えばメチレン、エチレン、プロピレ ン、ブチレンを表わし、R⁵、R⁶はそれぞれ独立に水素 30 原子、炭素数1~12の置換、無置換のアルキル基、ア ルケニル基、アラルキル基、アリール基、例えばメチル 基、エチル基、ベンジル基等を表わす)および親水性カ チオン基、例えば - +N(R⁵)(R⁶)(R⁷)・Y - (式中、 R⁵、R⁶、R⁷は前記R⁵と同義であり、Y- は無機もし くは有機の陰イオンを表わし、ヒドロキシ基、ハロゲン 基、硫酸基、炭酸基、過塩素酸基、有機カルボン酸基、 有機スルホン酸基、有機硫酸基等を表わす)であり、お よび好ましくは親水性アニオン基、例えば-SO₃M 、-OSO $_{3}$ M, $_{-}COOM$, $_{-}O-PO(OM)_{2}$, $_{-}PO(OM)_{2}$, $_{-}O-PO(OM)$ (0-A-R f)、-PO(OM)(O-A-Rf)等が挙げられる。ここでMは無機 又は有機の陽イオンを表わし、好ましくは水素原子、ア ルカリ金属(Li[†]、Na[†]、K[†]など)、アルカリ土類金属 (Mg^{2*}、Ca^{2*} など)、炭素数0~18のアンモニウム、 低級アルキルアミン等である。 A及びRfは前記と同義 である。本発明で用いることができる代表的なフッ素含 有界面活性剤の具体例を以下に示す。

[0035]

【化4】

1-1

C₇F₁₅COOH

 $H + CF_2 + CH_2COONH_4$

 $C_8F_{17}SO_3K$

1-4

C₈F₁₇SO₂N-CH₂COOK

 $\text{H} \xrightarrow{\hspace{0.1cm} \leftarrow} \text{CF}_2 \xrightarrow{\hspace{0.1cm} \rightarrow_6} \text{COOCH}_2 \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{CO}_3 \text{Na}$

1-3

1-6

1-2

1-8

H-(CF₂)6 CH₂OOC-CH-SO₃Na

1-9

 $H + CF_2 \rightarrow_6 CH_2O + CH_2CH_2O \rightarrow_p OC - CH_2$

 $H - (CF_2)_6 CH_2O + CH_2CH_2O)_p - OC - CH - CH_2SO_3K$

p:平均3

 $C_8F_{17}SO_2N - (CH_2CH_2O)_p - (CH_2)_4 SO_3Na$

1-11

1-12

 $C_{10}F_{21}CH_2CH_2O + CH_2CH_2O + CH_2CH_2O + CH_2 + CH_2O + CH_2O$

p:平均6

【化5】

[0036]

|-14
$$\begin{bmatrix} C_3H_7 & O \\ C_8F_{17}SO_2N & (CH_2CH_2O)_p \end{bmatrix}_2^{O}$$
 | P-ONa p: \Pi\$

I-15 C₈F₁₇SO₂N-CH₂CH₂OSO₃Na I-16 H(CF₂)₆COONH₄

I-17 H(CF₂)₆COONH₄

I-18 C₈F₁₇SO₂NHCH₂CH₂SO₃Na

1-19 C₈F₁₇SO₂Li

1-20 C₉F₁₉COONH₄

I-21 (C₈F₁₇SO₂NCH₂CH₂)₂C(CH₂N(CH₂)₄SO₃Na)₂ COCH₃

$$C_8F_{17}CH_2CH_2OC$$

COONa

COONa

COONa

I-23 $C_8F_{17}SO_2NH(CH_2)_3N^+(CH_3)_3\Gamma$

1-24 $C_8F_{17}SO_2NH(CH_2)_3N^{+}(CH_3)_3Br^{-}$

I-25 $C_7F_{15}CONH(CH_2)_3N^+(CH_3)_3\Gamma$

 $\begin{array}{ccc}
C_3H_7 & \oplus & \ominus \\
I-26 & C_8F_{17}SO_2N-CH_2CH_2N(CH_3)\cdot Cl
\end{array}$

1-27 C₇F₁₅CONHCH₂CH₂N Cl ⊖

[0037]

【化6】

```
特開2001-5137
24
```

1-29
$$C_8F_{17}SO_2NHCH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_2$$
 $N(CH_3)_3 \cdot CH_3$ $-CH_3$

$$\begin{array}{c} \text{I-31} & \text{C}_{16}\text{H}_{33}\text{O-OC-CH-SO}_{3}\text{Na} \\ \text{C}_{8}\text{F}_{17}\text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{OOC-CH-SO}_{3}\text{Na} \end{array}$$

$$C_3H_7$$

 $C_8F_{17}SO_2N$ CH_2CHCH_2O CH_2O $CH_$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{(OCH}_2\text{CH}_2)}_3 \overset{\text{CH}_3}{\text{N-CH}_3} \cdot \text{CH}_3 & -\text{CO} \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

30 【0039】 【化8】

1-37
$$C_8F_{17}SO_2NH(-CH_2)_3N(CH_3)_3\cdot Br^{\Theta}$$

I-39 $C_9F_{19}CONH(CH_2)_3N^+(CH_3)_3\Gamma$

I-40 $H(CF_2CF_2)_4CONH(CH_2)_3N^+(CH_3)_3$

	(14)
25 I -41	C ₆ F ₁₁ O(CH ₂ CH ₂ O) ₁₀ CH ₃
I-42	$C_6F_{11}O(CH_2CH_2O)_{20}C_6H_{13}$
I -43	$C_6F_{11}O(CH_2CH_2O)_{25}C_8H_{17}$
I <i>-</i> 44, 45	$C_6F_{11}O(CH_2CH_2O)_nC_6F_{11}$ $\left(\frac{I-44}{n=22}, \frac{I-45}{n=35}\right)$
I <i>-</i> 46	H-(CF ₂) ₈ -CH ₂ O-(CH ₂ CH ₂ O) ₁₀ H
I-47	C ₈ F ₁₇ CH ₂ CH ₂ O (CH ₂ CH ₂ O) ₁₅ H
I <i>-</i> 48	$C_8F_{17}SO_2N$ ($CH_2CH_2O)_{12}H$ C_3H_7
I-49	C ₈ F ₁₇ SO ₂ N-CH ₂ CH ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₁₅ OH C ₃ H ₇
I - 50	C ₈ F ₁₇ SO ₂ N-CH ₂ COO(CH ₂ CH ₂ O) ₄₀ H C ₂ H ₅
I-51	C ₈ F ₁₇ SO ₂ N (CH ₂ CH ₂ O) ₁₆ H C ₁₀ H ₂₁
I -52	$C_8F_{17}O(CH_2CH_2O)_{20}$ \longrightarrow CH_3
I-53	C ₈ F ₁₇ O-(CH ₂ CH ₂ O) ₂₅ H
	【化9】

[0040]

【0041】本発明においては、フッ素含有界面活性剤の塗設量は、1㎡当り250mg以下0.01mg以上である。好ましくは100mg以下0.1mg以上であり、より好ましくは50mg以下0.5mgの範囲である。フッ素含有界面活性剤に用いられる溶媒としては、水や先に記載した通常の有機溶媒を適宜選択し、使用することができる。好ましくはアルコール類、ケトン類、グリコール誘導体類、低級脂肪酸エステル類、ハロアルカン類、炭化水素類である。特に好ましくは、水を混合使用する溶媒系においては、水と混和して均一溶媒となるアルコール類、ケトン類、グリコール誘導体類の中から選ばれる溶媒であり、水不使用の場合の溶媒としてはアルコール

類、ケトン類、低級脂肪酸エステル類、ハロアルカン 40 類、炭化水素類である。上記の有機溶媒は、同一もしく は異なる種類の溶媒を2種以上混合して用いることはな んら差し支えない。また水-有機溶媒の混合溶媒として 使用する場合のその混合比は任意にとることができ、特 に制限はない。

【0042】滑り剤分散粒子の含有層である最外層の塗布方式は、前記RD307105、第XV章に記載されている。例えば、先に挙げた塗布方式のエアードクター、ブレード、エアナイフ、スクイズ、含浸、リバースロール、トランスファーロール、グラビア、キス、キャス50ト、スプレイ、ディップ、バー、エクストリュージョン

等を挙げることができる。本発明では、上記のフッ素含有界面活性剤と組み合せて非フッ素含有界面活性剤を用いることも好ましく、カチオン系、アニオン系、ベタイン系、ノニオン系非フッ素含有界面活性剤をいずれも使用することができる。好ましくはカチオン系、アニオン系である。フッ素含有界面活性剤とは、アニオン系である。フッ素含有界面活性剤の組み合せは、フッ素含有界面活性剤の組み合せも1種を任意に選択して数字上の組み合せ可能な場合のすべてを使用できるが、好ましくはフッ素含有界面活性剤のいずれか一方がカチオン系で他方がアニオン系界面活性剤の組み合せもとチオン系で他方がアニオン系界面活性剤の組み合せも

[0044]

29

* くはそれにノニオン系界面活性剤が加わった組み合せ使用である。特にカチオン系界面活性剤がフッ素含有界面活性剤であってアニオン系界面活性剤が非フッ素含有界面活性剤の組み合せ、またはこれにノニオン系フッ素含有もしくは非フッ素含有界面活性剤の組み合せ使用である。これは、帯電列的に負帯電性を有するフッ素系界面活性剤と正帯電性を有する非フッ素系界面活性剤を最適量使用して、帯電列を調整し接触する相手材質との発電性を小さくすることで、本発明で好ましく用いられるものである。以下に非フッ素含有界面活性剤の代表的な化合物例を挙げる。

[0043] 【化10】

N-1	C ₁₂ H ₂₅ O(CH ₂ CH ₂ O) ₁₀ •H
N-2	$C_{16}H_{33}O(CH_2CH_2O)_{20} \cdot H$
N-3	$C_{24}H_{49}O(CH_2CH_2O)_{30} \cdot H$
N-4	$C_{32}H_{65}O(CH_2CH_2O)_{15} \cdot H$
N-5	$C_{50}H_{101}O(CH_2CH_2O)_{16}\cdot H$
N-6	$C_{14}H_{29}N < (CH_2CH_2O)_mH (CH_2CH_2O)_nH $ m+n=30
N-7	$C_{11}H_{23}N < (CH_2CH_2O)_m \cdot H $ m+n=20
N-8, 9, 10	C_9H_{19} \longrightarrow $O(CH_2CH_2O)_n$ \cdot H $\binom{N-8}{n=10}$, $\binom{N-9}{n=25}$, $\binom{N-10}{n=50}$
N-11	C ₉ H ₁₉ O(CH ₂ CHCH ₂ O) ₅ ·H OH
N-12	C ₈ H ₁₇ -O(CH ₂ CHCH ₂ O) ₁₅ ·H OH
N-13	C_9H_{19} $O(CH_2CH_2O)_{10}$ $O(CH_2CHO)_5$ $O(CHO)_5$
	【化11】

N-14 ポリオキシェチレンソルビタンモノラウリン酸エステル(n=20)

N-15 ポリオキシエチレンソルピタンモノオレイン酸エステル(n=15)

N-16 ポリオキシエチレンソルビタントリステアリン酸エステル(n=30)

N-17 HO(CH₂CH₂O)₂₀·H

N-18 C₈H₁₇-O(CH₂CH₂O)₁₀H

N-19 ソルピタンモノラウレート

N-20 グリセリルモノオレエート

[0045]

$$A-1$$
 $C_{12}H_{25}$ \longrightarrow SO_3Na

A-3
$$(C_4H_9)n$$
 \bigcirc SO_3Na $n = 2$

A-4 (i-C₃H₇) SO₃Na
$$n = 3$$

A-5 $C_{12}H_{25}OSO_3Na$

A-9
$$\left[C_9H_{19} - \bigcirc - O(CH_2CH_2O)_{10} \right]_n^O \stackrel{\text{II}}{\text{P-(ONa)}_{3-n}}$$

$$t_1=1, 2 (混合物)$$

[0046]

【化13】

$$K-1 \qquad C_{16}H_{33}N(CH_3)_3 \qquad Cl$$

$$K-2 \qquad (C_4H_9)_4N \quad Br$$

$$K-3 \qquad C_{12}H_{25}N \qquad (CH_2CH_2O)_pH \qquad Br$$

$$C_4H_9 \qquad p+q=10$$

$$K-4 \qquad C_{18}H_{33}N(CH_2CH_2OH)_3 \qquad Cl$$

$$K-5 \qquad C_{16}H_{33}N(CH_3)_3 \quad Br$$

$$CH_2 - \bigcirc$$

$$K-6 \qquad C_{11}H_{23}CONH(CH_2)_3N(CH_3)_3 \quad Cl$$

$$K-7 \qquad C_{16}H_{33} - N\bigcirc \qquad Cl$$

$$K-8 \qquad C_{12}H_{25} - N \rightarrow O \quad Br$$

$$C_2H_5 \qquad N \rightarrow Cl$$

$$K-9 \qquad C_{12}H_{25} - N \rightarrow O \quad Cl$$

CH₃

C₁₂H₂₅-N N-CH₂

【0047】フッ素含有界面活性剤と併用する非フッ素含有界面活性剤の使用量は、1m²当り200mg以下である。好ましくは100mg以下である。特に好ましくは50mg以下1mg以上である。非フッ素含有界面活性剤を全く使用しない場合も含まれ、その全塗設量は上記に同じである。非フッ素含有界面活性剤はフッ素含有界面活性剤と併用されるので溶媒等は、前記フッ素含有界面活40

性剤に同じである。なお、前記組み合せ使用におけるカチオン系界面活性剤/アニオン系界面活性剤のモル比は $0.01\sim100$ の範囲である。好ましくは $0.1\sim10$ である。より好ましくは $0.2\sim2$ の範囲である。イオンコンプレックスの代表的な具体例を下記に示す。

【0048】 【化14】

IC-1

 $C_8F_{17}SO_2NH(CH_2)_3N(CH_3)_3 \cdot (i-C_3H_7)_8$

IC-2

C₈F₁₇SO₂NH(CH₂)₃N (CH₃)₃·C₈H₁₇ -⟨O⟩-(CCH₂CH₂)₃SO₃ Θ

IC-3

 $C_8F_{17}SO_2NH(CH_2)_3N(CH_3)_3$ $C_4H_9CHCH_2OCOCH_2$ $C_4H_9CHCH_2OCOCH-SO_3$

IC-4 $C_8F_{17}SO_2NH(CH_2)_3N(CH_3)_3 \cdot \left[C_9H_{19} - \bigcirc O(CH_2CH_2O)\right]_{10} \cap O(CH_2CH_2O)$

IC-5

 $C_8F_{17}SO_2NHCH_2CH_2O(CH_2)_3N^{\Theta}(CH_3)_3 \cdot C_{13}H_{27} - O SO_3^{\Theta}$

IC-6

 $\begin{array}{c} C_{3}H_{7} \\ \downarrow \\ C_{16}H_{33}N \text{ (CH}_{3})_{3} \cdot C_{8}F_{17}SO_{2}N \text{ (CH}_{2}CH_{2}O \text{)4 (CH}_{2})_{4}-SO_{3}^{\Theta} \end{array}$

[0049]

【化15】

C₁₂H₂₅OCOCH₂
C₈F₁₇SO₂NH(CH₂)₃N (CH₃)₃· C₁₂H₂₅OCOCH₂
C₁₂H₂₅OCOCH-SO₃Θ

$$|C-8| C_7F_{15}CONH(CH_2)_3N(CH_3)_3\cdot (C_4H_9)_2 \longrightarrow SO_3^{\epsilon}$$

O | O | I | C-10
$$C_9F_{19}CONH(CH_2)_3N(CH_3)_3 \cdot (C_{12}H_{25}O)_2 \cdot P \cdot O(CH_2)_4SO_3^{\Theta}$$

$$|C-12 \quad C_{18}H_{33}N \quad (CH_3)_3 \cdot C_{12}H_{25}OSO_3^{\Theta}$$

1C-13

$$\left[C_8F_{17}SO_2NH(CH_2)_3N(CH_3)_3\right]$$
 C_9H_{19} $O(CH_2CH_2O)_{10}$ $P-(O^{\circ})_2$

【0050】本発明においては、導電性帯電防止剤から なる帯電防止層が好ましく用いられる。それらの帯電防 止剤としては、特に制限はなく、有機物でもよくまた無 機化合物でもよい。有機物の場合は、アニオン、カチオ ン、ノニオンのいずれでもよく低分子化合物でも高分子 化合物でもいずれでも良い。有機化合物の場合は、高分 子ポリマーが好ましく、たとえばアニオン性高分子電解 質としてはカルボン酸及びその塩、スルホン酸塩を含む 高分子で、例えば特開昭48-22017号、特公昭4 6-24159号、特開昭51-30725号、特開昭 51-129216号、特開昭55-95942号に記 載されているような高分子である。また、カチオン性高 分子としては例えば特開昭49-121523号、特開 昭48-91165号、特公昭49-24582号に記 載されているようなものがある。また低分子化合物とし てのイオン性界面活性剤もアニオン性とカチオン性とが あり、例えば特開昭49-85826号、特開昭49-33630号、米国特許第2.992.108、米国特 許第3, 206, 312、特開昭48-87826号、 特公昭49-11:567号、特公昭49-11568 号、特開昭55-70837号などに記載されているよ うな化合物を挙げることができる。

【0051】また無機導電性材料による帯電防止層は非常に有用であり、その中でも帯電防止剤として好ましいものは、ZnO、TiO²、SnO2、A12 O3、In2

O3、SiO2、MgO、BaO、MoO3、V2 O5の中で から選ばれた少くとも1種の金属酸化物あるいはこれら の複合酸化物 (Sb, P, B, In, S, Si, Cな ど)の微粒子であり、それらは結晶性でもゾル状のもの でもよい。さらにまた、導電性カーボン粒子でもよい。 本発明に使用される導電性の結晶性またはゾル状金属酸 化物又はその複合酸化物の微粒子は、その体積抵抗率が $10^{7}\Omega$ - c m以下、より好ましくは $10^{8}\Omega$ - c m以下 であり、特に好ましくは $10^2\Omega$ -cm以下である。そ の形状は特に限定されず、球状、棒状、針状、鱗片状あ るいは板状など種々挙げることができる。さらにまた中 空状でもよくカーボンナノファイバーなる素材が該当す る。その一次粒子サイズは 0.0005~2μm、特に 0. 001~1 μ m であることが望ましい。更に効率良 く導電性を与えるために、一次微粒子を一部凝集(2~ 10000個の凝集体など)させて、0.01~0.5 μmにした導電性の結晶性あるいはゾル状の酸化物又は その複合酸化物の微粒子やフィラーの集合体を用いるこ とが好ましい。なお、これらの導電性粒子はその結晶子 サイズと粒子のサイズとの関係は特に限定されず、結晶 性の高い場合は結晶子サイズと粒子サイズとの比は 1/ 1であり、結晶性が低くアモルファスの場合はその比は 1/2000も有り得る。これらを用いて帯電防止層を 作製する場合に到達する導電性としては、好ましくは 50 生 熱現像処理後共にその雷気抵抗が 1 0¹² Ω以下であ

り、より好ましくは 10^{10} Ω 以下、特に好ましいのは電気抵抗が $10^{9.5}$ Ω 以下である。表記の導電性帯電防止層の位置は特に限定されず、バック側だけでなく乳剤側の少なくとも一層にあれば良い。さらに最表面でも内部でもよく特に限定されない。

39

【0052】特に本発明で用いる導電性材料では導電性 アンチモン含有酸化錫微粉末が有用であり、それらは市 販品として容易に入手でき、球形や針状の素材がある。 特にこの中で有用な針状導電性アンチモン含有酸化錫粉 末について詳細に記す。これは、少なくとも一方に短軸 平均粒子径が0.005~1μmであり長軸平均粒子径 が $0.05 \sim 10 \mu$ mであってアスペクト比が 3以上で かつ比抵抗が1 k Ω・c m以下である針状導電性アンチ モン含有酸化錫粉末する層を有することを特徴とし、以 下に詳細に記す。ここで、針状とは、その物性値の範囲 内において針状のもののほかに、繊維状、柱状、棒状、 **燐片状、その他類似状のものも包含される。本発明で用** いる針状導電性アンチモン含有酸化錫微粉末状粉末は、 基体粒子としての針状酸化錫の表面に含水アンチモンを 沈着した後、焼成することにより得ることが出来る。ま た、あらかじめ酸化錫を作成する段階で酸化アンチモン を含有させることでも作成できる。本発明で用いる針状 導電性アンチモン含有酸化錫微粉末は、その作成方法に おいて特に限定されないが、これらの作成方法は例えば 特開平9-12314号、同8-231222号、同8 -217445号、同8-217444号、US-55 75957号、EP-719730号、特開昭56-1 20519号、同62-158199号などの詳細に記 載されている。

【0053】本発明において好ましく用いられる針状導 電性アンチモン含有酸化錫微粉末は、少なくとも一方に 短軸平均粒子径が0.005~1μmであり長軸平均粒 子径が $0.05\sim10\mu$ mであってアスペクト比が3以 上でかつ比抵抗が $1 k \Omega \cdot c m$ 以下であるが、好ましく は短軸平均粒子径が0.005~0.5μmであり更に 好ましくは 0.05~0.2 μ m であり、長軸平均粒 子径が $0.05\sim10\mu m$ 、より好ましくは $0.1\sim5$ μ mであり特に好ましくは 0. $1 \sim 3$ である。 短軸平均 粒子径と長軸平均粒子径のアスペクト比が3以上である が、好ましくは5以上特に好ましくは7以上である。 又、針状導電性アンチモン含有酸化錫微粉末状の比抵抗 は、 $1 k \Omega \cdot c m$ 以下であり好ましくは $500 \Omega \cdot c m$ 以下特に好ましくは100Ω・cm以下である。更に効 率良く導電性を与えるために、一次微粒子を一部凝集さ せて $0.05\sim1.0\mu$ mにした針状導電性アンチモン 含有酸化錫微粉末状の凝集体を用いることが好ましい。 また、これらを用いて帯電防止層を作製する場合に到達 する導電性としては、好ましくはその電気抵抗が1012 Ω 以下であり、より好ましくは 10^{10} Ω 以下、特に好ま しいのは電気抵抗が10^{9.5} Ω以下である。

【0054】次に、導電性材料が好ましく用いられるバ インダーについて記す。本発明に用いられるバインダー は従来、各種の結合剤として使用されている公知の熱可 塑性樹脂、熱硬化性樹脂、放射線硬化性樹脂、反応型樹 脂、酸、アルカリ又は生分解性ポリマー、天然物重合体 (蛋白質、セルロース誘導体、糖誘導体など) およびこ れらの混合物を使用することができる。好ましい上記樹 脂のTgは-40℃~300℃、重量平均分子量は0. 2万~100万、好ましくは0.5万~30万である。 上記熱可塑性樹脂としては、ビニル系共重合体、ニトロ セルロース、セルロースジアセテート、セルローストリ アセテート、セルロースアセテートプロピオネート、セ ルロースアセテートプチレート、セルローストリプロピ オネート、セルロースドデカノエート樹脂などのセルロ ース誘導体、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹 脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリエステルポリウレ タン樹脂、ポリエーテルポリウレタン樹脂、ポリカーボ ネートポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエー テル樹脂、ポリアミド樹脂、アミノ樹脂、スチレンブタ ジエン樹脂、ブタジエンアクリロニトリル樹脂等のゴム 系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂を挙げること ができる。

40

【0055】以上列挙のバインダーは単独または数種混 合で使用され、クロロシアヌル酸系、ビニルスルホン 系、エポキシ系、アジリジン系、イソシアネート系の公 知の架橋剤、および/あるいは放射線硬化型ビニル系モ ノマーを添加して硬化処理することができる。イソシア ネート系架橋剤としてはイソシアネート基を2個以上有 するポリイソシアネート化合物で、たとえばトリレンジ イソシアネート、4, 4'ージフェニルメタンジイソシ アネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレ ンジイソシアネート、ナフチレン-1,5-ジイソシア ネート、o-トルイジンジイソシアネート、イソホロン ジイソシアネート、トリフェニルメタンジイソシアネー トなどのイソシアネート類、これらのイソシアネート類 とポリアルコールとの反応生成物(例えば、トリレンジ イソシアナート3molとトリメチロールプロパン1m o l の反応生成物)、及びこれらのイソシアネート類の 縮合により生成したポリイソシアネート、などがあげら 40 れる。また、エポキシ系としては、ネオペンチルアルコ ールトリグリシジル、ペンタエリスリトールテトラグリ シジル、ジペンタエリスリトールヘキサグリシジル、グ リセリントリグリシジルなどを挙げることが出来る。 【0056】また、導電性化合物を有する層に親水性バ インダーも使用できる。使用する親水性バインダーとし ては、リサーチ・ディスクロージャー No. 1 7 6 4 3、

26頁、および同 No. 18716、651頁に記載され

ており、水溶性ポリマー、セルロースエステル、ラテッ

クスポリマー、水溶性ポリエステルなどが例示されてい

る。水溶性ポリマーとしては、ゼラチン、ゼラチン誘導

50

50

体、カゼイン、寒天、アルギン酸ソーダ、でんぷん、ポリビニールアルコール、ポリアクリル酸共重合体、無水マレイン酸共重合体などであり、セルロースエステルとしてはカルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースなどである。ラテックスポリマーとしては塩化ビニル含有共重合体、塩化ビニリデン含有共重合体、アクリル酸エステル含有共重合体、酢酸ビニル含有共重合体、ブタジエン含有共重合体などである。この中で最も好ましいのはゼラチンであり、アルカリ処理や酸処理ゼラチンが挙げられ、その中に残存する塩類については特に限定されないが、好ましくはカルシウムが3000pm以下より好ましくは2000pm以下であり、特に1000pmが好ましく500pm以下が更に好ましい。

41

【0057】前述の導電性アンチモン含有酸化錫微粉末 を上記バインダー中に分散する方法は、例えば特開平6 -35092の他、種々の公知の手段が可能であるが、 ニーダー、ピン型ミル、アニュラー型ミルなどが好まし く、ニーダーとピン型ミル、もしくはニーダーとアニュ ラー型ミルの併用も好ましい。ニーダーとしては、開放 型(オープン)、密閉型、連続型などがあり、その他3 本ロールミル、ラボプラストミル等の混練機も用いられ る。また、分散に際して特開平5-088283記載の 分散剤や、その他の公知の分散剤が使用できる。導電性 帯電防止剤の含有量としては、5~500mg/m^²が好ま しく、特に好ましくは10~350mg/m²である。また、 バインダーの量は $1 \sim 500$ mg/m^{*}が好ましく、特 に $5\sim300$ mg/m²が好ましい。導電性の結晶性あ るいはゾル状酸化物又はその複合酸化物の微粒子とバイ ンダーの量の比は1/300~100/1が好ましく、 より好ましくは1/100~100/5である。導電層 は、画像材料の少なくとも片面に設けられ、塗布又は印 刷によって全面またはストライプ状に設けることができ る。導電層を塗布する方法としてはエアードクターコー ト、ブレードコート、エアナイフコート、スクイズコー ト、含浸コート、リバースロールコート、トランスファ ーロールコート、グラビヤコート、キスコート、キャス トコート、スプレイコート、ディップコート、バーコー ト、エクストリュージョンコート等が利用出来、その他 の方法も可能であり、これらの具体的説明は朝倉書店発 行の「コーティング工学」253頁~277頁(昭和4 6. 3. 20. 発行) に詳細に記載されている。

【0058】次に本発明において好ましく用いられる塩化ビニリデン下塗り層について記述する。本発明の熱現像画像記録材料は、熱現像処理によって画像を形成するものであり、その現像温度は80℃以上140℃以下である。この場合の熱現像処理における加熱には、画像形成のための加熱のみならず、処理ムラの抑制などを目的とした予備加熱なども包含される。従って、現像は一定温度で行うものであってもよく、一定温度での加熱のの

ちにこれより高い温度で加熱を行うような多段階加熱で あってもよい。このような熱現像画像記録材料におい て、塩化ビニリデン共重合体を含有する0.3μπ以上 の厚さ(片面当たりの合計厚)の下塗り層で両面を被覆 した支持体を用いることによって、熱現像後の経時によ る寸法変化を防止することができる。そして、熱現像時 に発生しやすいシワの発生をなくすことが可能であり、 かつ熱現像に伴う寸法変化を抑えることが可能であるた め、上記の熱現像後の経時による寸法変化は極めて小さ いものとなることも大きな優位な技術である。特に、本 発明では、二軸延伸したポリエステル支持体が好ましく 用いられるが、このような支持体では、好ましくは下塗 り層を設けた後に熱処理を施すことによって、支持体自 体の加熱による寸法変化やベコの発生が抑えられる。し たがって、熱処理した後のポリエステル支持体を用いる と、熱現像画像記録材料の熱現像時のシワの発生がなく なり、熱現像前後の寸法変化が小さくなる。そのために は、本発明で好ましく用いられるポリエステル支持体 を、熱処理、好ましくは塩化ビニリデンを含有する下塗 り層を設けた後に130℃以上185℃以下の温度で熱 処理を行う。

【0059】これに対し、本発明と異なり、支持体の両 面を被覆する下塗り層に塩化ビニリデン共重合体以外の 重合体(例えばスチレンーブタジエン系共重合体)のみ を用いると、熱現像後の経時による寸法変化を抑えるこ とができない。また、この塩化ビニリデン共重合体下塗 り層の厚さ(片面当たりの合計厚)が 0. 3 μπ未満と なっても熱現像後の経時による寸法変化は抑えられなく なる。本発明で用いる塩化ビニリデン共重合体は、70 ~99.9重量%、より好ましくは85~99重量%の 塩化ビニリデン単量体と0.1~5重量%、より好まし くは0.2~3重量%のカルボキシル基含有ビニル単量 体を含有する共重合体であることが好ましい。本発明で 用いる塩化ビニリデン共重合体組成について詳細に記載 する。塩化ビニリデン共重合体に用いられるカルボキシ ル基含有ビニル単量体とは分子内に1つ以上のカルボキ シル基を有するビニル単量体で、具体例としてアクリル 酸、メタクリル酸、イタコン酸、シトラコン酸などを挙 げることができる。本発明で用いる塩化ビニリデン共重 合体には塩化ビニリデン単量体、カルボキシル基含有単 量体以外にこれらと共重合可能な単量体の繰り返し単位 を含有させてもよい。これら共重合可能な単量体の具体 例として、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、メ チルアクリレート、エチルアクリレート、メチルメタク リレート、グリシジルメタクリレート、2ーヒドロキシ エチルメタクリレート、ビニルアセテート、アクリルア ミド、スチレン等を挙げることができる。これらの共重 合可能な単量体は単独で用いても2種以上併用してもよ

【0060】本発明で用いる塩化ビニリデン共重合体の

分子量は、重量平均分子量で45000以下、さらには10000 以上45000以下が好ましい。分子量が大きくなると塩化 ビニリデン共重合体層とポリエステル等の支持体層との 接着性が悪化してしまう。本発明で用いる場合、塩化ビ ニリデン共重合体は有機溶媒に溶かした形態でも、ラテ ックスの水分散物の形態でもどちらでも良いが、ラテッ クスの水分散物の形態の方が好ましい。この場合、均一 構造のポリマー粒子のラテックスであってもコア部とシ ェル部で組成の異なったいわゆるコアーシェル構造のポ リマー粒子のラテックスでもよい。ラテックス中のポリ マー粒子の粒径等については、後述の画像形成層や保護 層のバインダーに用いられるものと同様である。塩化ビ ニリデン共重合体の単量体単位の配列については限定さ れず、周期、ランダム、ブロック等のいずれであっても よい。塩化ビニリデン共重合体の具体例として以下のも のを挙げることができる。ただし()内の数字は重量 比を表す。また平均分子量は重量平均分子量を表す。

43

[0061]V-1塩化ビニリデン:メチルアクリレ ート:アクリル酸(90:9:1)のラテックス(平均分子 量42000)

塩化ビニリデン:メチルアクリレート:メチル V-2メタクリレート:アクリロニトリル:メタクリル酸(8 7:4:4:4:1) のラテックス(平均分子量40000) 塩化ビニリデン:メチルメタクリレート:グリ シジルメタクリレート:メタクリル酸(90:6:2:2) のラテックス (平均分子量38000)

塩化ビニリデン:エチルメタクリレート:2-ヒドロキシエチルメタクリレート:アクリル酸(90: 8:1.5:0.5) のラテックス (平均分子量44000)

%、シェル部10重量%)

コア部 塩化ビニリデン:メチルアクリレート:メチル メタクリレート:アクリロニトリル:アクリル酸(93: 3:3:0.9:0.1

シェル部 塩化ビニリデン:メチルアクリレート:メチ ルメタクリレート:アクリロニトリル:アクリル酸(8) 8:3:3:3:3) (平均分子量38000)

コアシェルタイプのラテックス(コア部70重量 V-6%、シェル部30重量%)

コア部 塩化ビニリデン:メチルアクリレート:メチル メタクリレート:アクリロニトリル:メタクリル酸(9 2.5:3:3:1:0.5)

シェル部 塩化ビニリデン:メチルアクリレート:メチ ルメタクリレート:アクリロニトリル:メタクリル酸 (90:3:3:1:3) (平均分子量20000)

【0062】塩化ビニリデン共重合体は単独で用いても 2種以上併用してもよい。下塗り層としての塩化ビニリ デン共重合体層は、下塗り層のどの層でもよく特に限定 されない。しかし中でも、支持体に直接設層される下塗 り層第1層として設けることが好ましく、通常は片面ご とに1層ずつ設けられるが、場合によっては2層以上設 けてもよい。2層以上の多層構成とするときは、塩化ビ ニリデン共重合体量が合計で本明細書で特定した範囲と なるようにすればよい。塩化ビニリデン共重合体層の厚 さは、塗布面状を良好のものとするために、好ましくは 0. 3 μm 以上 4 μm以下、より好ましくは 0. 6 μm以 上3μm以下、更に好ましくは1.0μm以上2μm以下 の範囲である。

【0063】本発明の熱現像画像記録材料は、好ましく 10 は、塩化ビニリデン共重合体を含有する下塗り層で両面 が被覆されたポリエステル支持体上に有機銀塩、還元剤 および感光性ハロゲン化銀を含む画像形成層を有し、画 像形成層上には少なくとも 1 層の保護層が設けられてい る。また、本発明の熱現像画像記録材料は、支持体に対 して、画像形成層を反対側に少なくとも1層のバック層 を有することが好ましく、画像形成層、保護層、そして バック層を有するときはバック層のバインダーとして、 合成ポリマーや天然ポリマーが用いられ、それらは疎水 性でもよく親水性でもよい。また、このような層には塩 20 化ビニリデン共重合体のほか、架橋剤やマット剤などを 含有させてもよい。

【0064】本発明の熱現像画像記録材料には、種々の 支持体を用いることができる。典型的な支持体は、ポリ エチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、 などのポリエステル、硝酸セルロース、セルロースエス テル、ポリビニルアセタール、ポリカーボネートなどを 含む。このうち二軸延伸したポリエステル、特にポリエ チレンテレフタレート(PET)は強度、寸法安定性、 耐薬品性などの点から好ましい。支持体の厚みは下塗り コアシェルタイプのラテックス (コア部90重量 30 層を除いたベース厚みで60~200μmであることが 好ましい。本発明の熱現像画像記録材料に用いる支持体 は二軸延伸時にフィルム中に残存する内部歪みを緩和さ せ、熱現像中に発生する熱収縮歪みをなくすために、1 30~185℃の温度範囲で熱処理を施したポリエステ ル、特にポリエチレンテレフタレートが好ましく用いら れる。このような熱緩和処理は温度範囲内の一定温度で 実施してもよく、昇温しながら実施してもよい。

> 【0065】支持体の熱処理はロール状で実施してもよ く、ウエッブ状で搬送しながら実施してもよい。ウエッ ブ状で搬送しながら実施する場合、熱処理時の支持体の 搬送張力は比較的低い方が好ましく、具体的には7kg/ cm[']以下、特に4. 2 kg/cm[']以下にすることが好まし い。このときの搬送張力の下限には特に制限はないが 0. 5 kg/cm² 程度である。このような熱処理は、支持 体に対する画像形成層やバック層の接着性を向上させる ための処理、塩化ビニリデン共重合体を含有する下塗り 層の設層等を施した後に行うことが好ましい。熱処理後 における支持体の120℃30秒加熱による熱収縮率は 縦方向(MD)が-0.03%~+0.01%、横方向 (TD) が $0\sim0$. 0.4%であることが好ましい。支持

45 体は必要に応じて塩化ビニリデン共重合体層のほか、S BR、ポリエステル、ゼラチン等をバインダーとする下 塗り層を塗布してもよい。これらの下塗り層は多層構成 としてもよく、また支持体に対して片面または両面に設 けてもよく、これら下塗り層の少なくとも一層を導電層 とすることができる。下塗り層の一般的厚み(1層当た り) \mathbf{t} 0. $\mathbf{0}$ 1~5 μ m、より好ましくは0. $\mathbf{0}$ 5~1 μπであってよく、導電層とするときの厚みは0.01 $\sim 1 \mu m$ 、より好ましくは0.03 $\sim 0.8 \mu m$ である。 【0066】次に、画像形成層や中間層、バック層、バ 10 以下のようなものがある。メチルメタクリレート/エチ ック保護層等のバインダーについて説明する。本発明で 用いるバインダーに好ましく用いるポリマーバインダー は水不溶な疎水性ポリマーが微細な粒子として水溶性の 分散媒中に分散したものである。分散状態としてはポリ マーが分散媒中に乳化されているもの、乳化重合された もの、ミセル分散されたもの、あるいはポリマー分子中 に部分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が分子状分散 したものなどいずれでもよい。分散粒子の平均粒径は1 ~5000nm、より好ましくは5~1000nm程度の範囲が好ま しい。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限はなく、 広い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を持つも のでもよい。ポリマーバインダーとしては通常の均一構 造のポリマーのラテックス以外、いわゆるコア/シェル 型のポリマーのラテックスでもよい。この場合コアとシ ェルはガラス転移温度を変えると好ましい場合がある。 【0067】本発明においてバインダーとして用いるポ リマーラテックスのポリマーのガラス転移温度(Tg) は保護層、バック層と画像形成層とでは好ましい温度範 囲が異なる。保護層、バック層は種々の機器と接触する ために膜強度、接着故障防止の観点から25℃~100 ℃のガラス転移温度が特に好ましく、画像形成層は熱現 像時に写真有用素材の拡散を促し、高Dmax、低カブリな ど良好な写真性を得るために-3.0℃~7.0℃のガラス 転移温度が好ましく、特に好ましくはガラス転移温度が 0℃~50℃である。ポリマーラテックスの最低造膜温 度(MFT)は-30° \sim 90°、より好ましくは0° \sim 7 0℃程度が好ましい。最低造膜温度をコントロールする ために造膜助剤を添加してもよい。造膜助剤は一時可塑 剤ともよばれポリマーラテックスの最低造膜温度を低下 させる有機化合物(通常有機溶剤)で、例えば前述の「合 成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(19

【0068】本発明においてポリマーラテックスに用い られるポリマー種としてはアクリル樹脂、酢酸ビニル樹 脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ゴム系樹 脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリオレフ ィン樹脂、またはこれらの共重合体などがある。ポリマ ーとしては直鎖のポリマーでも枝分かれしたポリマーで も、また架橋されたポリマーでも良い。またポリマーと しては単一のモノマーが重合したいわゆるホモポリマー

70))」に記載されている。

でも良いし、二種以上のモノマーが重合したコポリマー でも良い。コポリマーの場合はランダムコポリマーでも ブロックコポリマーでも良い。ポリマーの分子量は重量 平均分子量で5000~100000、好ましくは1 0000~10000程度が好ましい。分子量が小さ すぎるものはバインダーとしての力学強度が不十分であ り、大きすぎるものは造膜性が悪く好ましくない。 【0069】本発明の熱現像画像記録材料のバインダー として用いられるポリマーラテックスの具体例としては ルメタクリレート/メタクリル酸コポリマー、メチルメ タクリレート/2-エチルヘキシルアクリレート/ヒド ロキシエチルメタクリレート/スチレン/アクリル酸コ ポリマー、スチレン/ブタジエン/アクリル酸コポリマ ー、スチレン/ブタジエン/ジビニルベンゼン/メタク リル酸コポリマー、メチルメタクリレート/塩化ビニル **/アクリル酸コポリマー、塩化ビニリデン/エチルアク** リレート/アクリロニトリル/メタクリル酸コポリマー など。またこのようなポリマーは市販もされていて、以 下のようなポリマーが利用できる。例えばアクリル樹脂 の例として、セビアンA-4635, 46583、4601(以上ダイセ ル化学工業(株)製)、Nipol Lx811、814、821、820、8 57、857x2(以上日本ゼオン(株)製)、VONCORT R3340、 R3360、R3370、4280、2830、2210(以上大日本インキ化 学(株) 製)、ジュリマーET-410、530、SEK101-SEK30 1、FC30、FC35(以上日本純薬(株)製)、ポリゾールF 410、AM200、AP50 (以上昭和高分子 (株) 製) など、ポ リエステル樹脂としては、FINETEX ES650、611、675、8 50(以上大日本インキ化学(株)製)、WD-size、WMS(以 上イーストマンケミカル製)など、ポリウレタン樹脂と してはHYDRAN AP10、20、30、40、VONDIC 1320NS(以上 大日本インキ化学(株)製)など、ゴム系樹脂としてはL ACSTAR 7310K、3307B、4700H、7132C、LQ-618-1(以上大 日本インキ化学(株) 製)、Nipol Lx416、410、430、43 5、2507(以上日本ゼオン(株)製)など、塩化ビニル樹 脂としてはNipol G351、G576(以上日本ゼオン(株)製) など、塩化ビニリデン樹脂としてはL502、L513(以上旭 化成工業(株)製)、アロンD7020、D5040、D5071(以上 東亜合成(株)製)など、オレフィン樹脂としてはケミ

【0070】ポリマーラテックスのうち中間層や保護層 用のバインダーとしては、アクリル系、スチレン系、ア **クリル/スチレン系、塩化ビニル系、塩化ビニリデン系** のポリマーラテックスが好ましく用いられる。具体的に はアクリル樹脂系のVONCORTR3370、4280、Nipol Lx85 7、メチルメタクリレート/2-エチルヘキシルアクリ 50 レート/ヒドロキシエチルメタクリレート/スチレン/

40 パールS120、SA100(以上三井石油化学(株)製)などを

い。

挙げることができる。これらポリマーは単独で用いても

よいし、必要に応じて二種以上ブレンドして用いても良

アクリル酸コポリマー、塩化ビニル樹脂のNipol G576、 塩化ビニリデン樹脂のアロンD5071が好ましく用いられ る。また画像形成層用のバインダーとしてはスチレン/ ブタジエン系のポリマーラテックスが好ましく用いら れ、具体的にはゴム系樹脂のLACSTAR3307B、Nipol Lx43 0、435が好ましく用いられる。バック層用のバインダー としては、アクリル系、オレフィン系、塩化ビニリデン 系のポリマーラテックスが用いられ、具体的にはアクリ ル樹脂系のジュリマーET-410、セビアンA-4635、ポリゾ ールF410など、オレフィン樹脂系のケミパールS120、塩 10 化ビニリデン系のL502、アロンD7020などが好ましい。 本発明で用いるバインダーには必要に応じて全バインダ ーの20wt%以下の範囲でポリビニルアルコール、メチ ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボ キシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセル ロースなどの親水性ポリマーを添加してもよい。これら 親水性ポリマーの添加量は保護層、画像形成層の全バイ ンダーの10wt%以下が好ましい。

47

【0071】本発明の熱現像画像記録材料における写真 構成層は水系の塗布液を塗布後乾燥して調製することが 好ましい。ただし、ここで言う「水系」とは塗布液の溶 媒(分散媒)の60wt%以上が水であることをいう。塗布 液の溶媒の水以外の成分としてはメチルアルコール、エ チルアルコール、イソプロピルアルコール、メチルセロ ソルブ、エチルセロソルブ、ジメチルホルムアミド、酢 酸エチル、ジアセトンアルコール、フルフリルアルコー ル、ベンジルアルコール、ジエチレングリコールモノエ チルエーテル、オキシエチルフェニルエーテルなどの水 混和性の有機溶媒を用いることができる。保護層用の全 バインダー量は $0.1 \sim 10.0 \text{g/m}^2$ 、より好ましく は $0.2\sim5.0$ g/ m^2 の範囲が好ましい。画像形成層 用の全バインダー量は $0.2\sim30g/n^2$ 、より好まし くは1. $0\sim15$ g/ n^2 の範囲が好ましい。バック層用 の全バインダー量は $0.01\sim15g/m^2$ 、より好まし くは $0.05\sim5$ g/ m^2 の範囲が好ましい。それぞれの 層には架橋のための架橋剤、塗布性改良のための界面活 性剤などを添加してもよい。これらの各層は、2層以上 設けられる場合がある。 画像形成層が 2 層以上である場 合は、すべての層のバインダーとしてポリマーラテック スを主に用いることが好ましい。また、保護層は画像形 成層上に設けられる層であり2層以上存在する場合の最 外層でない層を指し、少なくとも1層が好ましい。ま た、バック層は支持体のバック面の下塗り層の上部に設 けられる層であり2層以上存在する場合もあるが、少な くとも1層、特に最外層のバック層にポリマーラテック スを用いることが好ましい。

【0072】本発明におけるベック平滑度は、日本工業規格(JIS)P8119「紙および板紙のベック試験器による平滑度試験方法」およびTAPPI標準法T479により容易に求めることができる。本発明の熱現像

画像記録材料の画像形成層を有する面およびその反対面の最外層表面の少なくとも一方、好ましくは両方のベック平滑度は、2000秒以下であり、より好ましくは10秒~2000秒である。熱現像画像記録材料の画像形成層を有する面の最外層表面およびその反対面の最外層表面のベック平滑度は、前記両面の層に含有させるマット剤と称される微粒子の平均粒径および添加量を種々変化させることによってコントロールすることができる。マット剤は画像形成層を有する面においては支持体から最も離れた最外層となる保護層に含有させることが好ましく、その反対側においては、最外層または最外層でないバック層に含有させることが好ましい。

【0073】本発明において好ましいマット剤の平均粒 径は、 $0.5\sim20\mu$ mの範囲であり、好ましくは1か ら10μmである。本発明において好ましいマット剤の 添加量は、5~400mg/m²、特に5~100mg/m²の 範囲である。本発明に用いられるマット剤は、写真的諸 特性に悪影響を及ぼさない固体粒子であれば、どのよう なものでもよい。無機系のマット剤としては、二酸化ケ イ素、チタンおよびアルミニウムの酸化物、亜鉛および カルシウムの炭酸塩、バリウムおよびカルシウムの硫酸 塩、カルシウムおよびアルミニウムのケイ酸塩など、有 機系のマット剤としては、セルロースエステル類、ポリ メチルメタクリレート、ポリスチレンまたはポリジビニ ルベンゼンおよびこれらのコポリマーなどの有機重合体 のマット剤が挙げられる。本発明では、特開平3-109542 号公報2頁左下欄8行目~3頁右上欄4行目に記載され た多孔性のマット剤、特開平4-127142号公報3頁右上欄 7行目~5頁右下欄4行に記載されたアルカリで表面修 30 飾したマット剤、特開平6-118542号公報の段落番号「0 005」から「0026」に記載された有機重合体のマ ット剤を用いることがより好ましい。また、これらのマ ット剤を2種以上併用してもよい。例えば、無機系のマ ット剤と有機系のマット剤の併用、多孔性のマット剤と 非多孔性のマット剤の併用、不定形のマット剤と球形の マット剤の併用、平均粒径の異なるマット剤の併用(例 えば特開平6-118542号に記載されている平均粒径が1. 5 μπ以上のマット剤と平均粒径が 1 μπ以下のマット剤 の併用)などがある。マット剤の含有層は最外層中でも よく、その下層あるいは画像形成層でもよい。マット剤 により形成される表面粗さは、表面からの突起部の平均 高さが0. $2 \mu m以上 1 0 \mu m以下であり、より好まし$ くは $0.5 \mu m$ 以上 $7 \mu m$ 以下である。

【0074】本発明の熱現像画像記録材料は、好ましくは感光性ハロゲン化銀を含む。本発明に用いられる感光性ハロゲン化銀は、塩化銀、塩臭化銀、ヨウ塩臭化銀のいずれでもよい。また、粒子内におけるハロゲン組成の分布は均一であってもよく、ハロゲン組成がステップ状に変化したものでもよく、あるいは連続的に変化したものでもよい。本発明における感光性ハロゲン化銀の形成

49 方法は当業界ではよく知られており例えば、リサーチデ ィスクロージャー1978年6月の第17029号、および米国特 許第3,700,458号に記載されている方法を用いることが できる。本発明で用いることのできる具体的な方法とし ては、調製された有機銀塩中にハロゲン含有化合物を添 加することにより有機銀塩の銀の一部を感光性ハロゲン 化銀に変換する方法、ゼラチンあるいは他のポリマー溶 液の中に銀供給化合物およびハロゲン供給化合物を添加 することにより感光性ハロゲン化銀粒子を調製し有機銀 塩と混合する方法を用いることができる。本発明におい て好ましくは後者の方法を用いることができる。感光性 ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く 抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には0. 20 μ m以下、より好ましくは0.01 μ m以上0.15 μ m以下、 更に好ましくは0.02 μ m以上0.12 μ m以下がよい。ここ でいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体ある いは八面体のいわゆる正常晶である場合にはハロゲン化 銀粒子の稜の長さをいう。また、ハロゲン化銀粒子が平 板状粒子である場合には主表面の投影面積と同面積の円 像に換算したときの直径をいう。その他正常晶でない場 合、例えば球状粒子、棒状粒子等の場合には、ハロゲン 化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいう。 【0075】ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体、 八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ 状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特 に立方体状粒子、平板状粒子が好ましい。平板状ハロゲ ン化銀粒子を用いる場合の平均アスペクト比は好ましく は100:1~2:1、より好ましくは50:1~3:1がよい。更 に、ハロゲン化銀粒子のコーナーが丸まった粒子も好ま しく用いることができる。感光性ハロゲン化銀粒子の外 表面の面指数(ミラー指数)については特に制限はない が、分光増感色素が吸着した場合の分光増感効率が高い

【0076】感光性ハロゲン化銀粒子は、周期律表の第VII族あるいは第VIII族(第7族~第10族)の金属または金属錯体を含有することが好ましい。周期律表の第VII族あるいは第VIII族の金属または金属錯体の中心金属として好ましくはロジウム、レニウム、ルテニウム、オスニウム、イリジウムである。これら金属錯体は1種類でもよいし、同種金属および異種金属の錯体を二種以上併用してもよい。好ましい含有率は銀1モルに対しInモルから10mモルの範囲が好ましく、10mモルから100μモルの範囲がより好ましい。具体的な金属錯体の構造としては特開平7-225449号等に記載された構造の金属錯体を用いることができる。ハロゲン化銀乳剤は化学増感さ

[100]面の占める割合が高いことが好ましい。その割合としては50%以上が好ましく、65%以上がより好ましく、

80%以上が更に好ましい。ミラー指数[100]面の比率は増

感色素の吸着における[111]面と[100]面との吸着依存性

を利用したT. Tani; J. Imaging Sci., 29、165(1985年)に記

載の方法により求めることができる。

れることが好ましい。化学増感の方法としては、硫黄増 感法、セレン増感法、テルル増感法、貴金属増感法など の知られている方法を用いることができ、単独または組 み合わせて用いられる。組み合わせて使用する場合に は、例えば、硫黄増感法と金増感法、硫黄増感法とセレ ン増感法と金増感法、硫黄増感法とテルル増感法と金増 感法、硫黄増感法とセレン増感法とテルル増感法と金増 感法などが好ましい。本発明に用いられる硫黄増感は、 通常、硫黄増感剤を添加して、40℃以上の高温で乳剤 を一定時間攪拌することにより行われる。硫黄増感剤と しては公知の化合物を使用することができ、例えば、ゼ ラチン中に含まれる硫黄化合物のほか、種々の硫黄化合 物、例えばチオ硫酸塩、チオ尿素類、チアゾール類、ロ ーダニン類等を用いることができる。好ましい硫黄化合 物は、チオ硫酸塩、チオ尿素化合物である。硫黄増感剤 の添加量は、化学熟成時のpH、温度、ハロゲン化銀粒 子の大きさなどの種々の条件下で変化するが、ハロゲン 化銀1モル当たり $10^{-7} \sim 10^{-2}$ モルであり、より好ま しくは $10^{-5} \sim 10^{-3}$ モルである。

【0077】ハロゲン化銀調製法としては、有機銀塩の 一部の銀を有機または無機のハロゲン化物でハロゲン化 するいわゆるハライデーション法も好ましく用いられ る。ここで用いる有機ハロゲン化物としては有機銀塩と 反応しハロゲン化銀を生成する化合物で有ればいかなる 物でもよいが、N-ハロゲノイミド(N-ブロモスクシンイ ミドなど)、ハロゲン化4級窒素化合物(臭化テトラブチ ルアンモニウムなど)、ハロゲン化4級窒素塩とハロゲン 分子の会合体(過臭化臭化ピリジニウム)などが挙げられ る。無機ハロゲン化合物としては有機銀塩と反応しハロ ゲン化銀を生成する化合物で有ればいかなる物でもよい が、ハロゲン化アルカリ金属またはアンモニウム(塩化 ナトリウム、臭化リチウム、沃化カリウム、臭化アンモ ニウムなど)、ハロゲン化アルカリ土類金属(臭化カルシ ウム、塩化マグネシウムなど)、ハロゲン化遷移金属(塩 化第2鉄、臭化第2銅など)、ハロゲン配位子を有する金 属錯体(臭化イリジウム酸ナトリウム、塩化ロジウム酸 アンモニウムなど)、ハロゲン分子(臭素、塩素、沃素) などがある。また、所望の有機無機ハロゲン化物を併用 しても良い。

40 【0078】ハライデーションする際のハロゲン化物の添加量としては有機銀塩1 モル当たりハロゲン原子として1mモル~500mモルが好ましく、10mモル~250mモルがさらに好ましい。本発明に用いることのできる有機銀塩は、光に対して比較的安定であるが、露光された光触媒(感光性ハロゲン化銀の潜像など)および還元剤の存在下で、80℃或いはそれ以上に加熱された場合に銀画像を形成する銀塩である。有機銀塩は銀イオンを還元できる源を含む任意の有機物質であってよい。有機酸の銀塩、特に(炭素数が10~30、好ましくは15~28の)長鎖脂肪カルボン酸の銀塩が好ましい。配位子が4.0~10.0の範囲

の錯安定度定数を有する有機または無機銀塩の錯体も好ましい。銀供給物質は、好ましくは画像形成層の約5~70重量%を構成することができる。好ましい有機銀塩はカルボキシル基を有する有機化合物の銀塩を含む。これらの例は、脂肪族カルボン酸の銀塩および芳香族カルボン酸の銀塩を含むがこれらに限定されることはない。脂肪族カルボン酸の銀塩の好ましい例としては、ベヘン酸銀、アラキジン酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、ラウリン酸銀、カプロン酸銀、ミリスチン酸銀、パルミチン酸銀、マレイン酸銀、フマル酸銀、酒石酸銀、リノール酸銀、酪酸銀および樟脳酸銀、これらの混合物などを含む。

51

【0079】本発明に用いることができる有機銀塩の形 状としては特に制限はないが、短軸と長軸を有する針状 結晶が好ましい。本発明においては短軸0.01μπ以上0.2 0μπ以下、長軸0.10μπ以上5.0μπ以下が好ましく、短 軸0.01 μ m以上0.15 μ m以下、長軸0.10 μ m以上4.0 μ m以 下がより好ましい。有機銀塩の粒子サイズ分布は単分散 であることが好ましい。単分散とは短軸、長軸それぞれ の長さの標準偏差を短軸、長軸それぞれで割った値の百 分率が好ましくは100%以下、より好ましくは80%以下、 更に好ましくは50%以下である。本発明に用いることの できる有機銀塩は、好ましくは脱塩をすることができ る。脱塩を行う方法としては特に制限はなく公知の方法 を用いることができるが、遠心濾過、吸引濾過、限外濾 過、凝集法によるフロック形成水洗等の公知の濾過方法 を好ましく用いることができる。本発明に用いることの できる有機銀塩は粒子サイズの小さい、凝集のない微粒 子を得る目的で、分散剤を使用した固体微粒子分散物と する方法が用いられる。有機銀塩を固体微粒子分散化す る方法は、分散助剤の存在下で公知の微細化手段(例え ば、ボールミル、振動ボールミル、遊星ボールミル、サ ンドミル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミ ル、高圧ホモジナイザー)を用い、機械的に分散するこ とができる。有機銀塩を分散剤を使用して固体微粒子化 する際には、例えば、ポリアクリル酸、アクリル酸の共 重合体、マレイン酸共重合体、マレイン酸モノエステル 共重合体、アクリロイルメチルプロパンスルホン酸共重 合体、などの合成アニオンポリマー、カルボキシメチル デンプン、カルボキシメチルセルロースなどの半合成ア ニオンポリマー、アルギン酸、ペクチン酸などのアニオ ン性ポリマー、特開昭52-92716号、W088/04794号など に記載のアニオン性界面活性剤、特開平9-17924 3号に記載の化合物、あるいは公知のアニオン性、ノニ オン性、カチオン性界面活性剤や、その他ポリビニルア ルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセ ルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシ プロピルメチルセルロース等の公知のポリマー、或いは ゼラチン等の自然界に存在する高分子化合物を適宜選択 して用いることができる。

【0080】本発明において有機銀塩は所望の量で使用 できるが、熱現像画像記録材料 1 ㎡ 当たりの量で示し て、銀量として0.1~5g/m²が好ましく、さらに好ましく は1~3g/m² である。本発明の熱現像画像記録材料には有 機銀塩のための還元剤を含むことが好ましい。有機銀塩 のための還元剤は、銀イオンを金属銀に還元する任意の 物質、好ましくは有機物質であってよい。フェニドン、 ハイドロキノンおよびカテコールなどの従来の写真現像 剤は有用であるが、ヒンダードフェノール還元剤が好ま しい。還元剤は、画像形成層を有する面の銀1モルに対 して5~50% (モル) 含まれることが好ましく、10~40% (モル) で含まれることがさらに好ましい。 還元剤の添 加層は画像形成層を有する面のいかなる層でも良い。画 像形成層以外の層に添加する場合は銀1モルに対して10 ~50%(モル)と多めに使用することが好ましい。ま た、還元剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導化 されたいわゆるプレカーサーであってもよい。有機銀塩 を利用した熱現像感光材料においては広範囲の色調剤が 特開昭46-6077号、同47-10282号、同49-5019号、同49-5 020号、同49-91215号、同49-91215号、同50-2524号、同 50-32927号、同50-67132号、同50-67641号、同50-11421 7号、同51-3223号、同51-27923号、同52-14788号、同52 -99813号、同53-1020号、同53-76020号、同54-156524 号、同54-156525号、同61-183642号、特開平4-56848 号、特公昭49-10727号、同54-20333号、米国特許3,080, 254号、同3,446,648号、同3,782,941号、同4,123,282 号、同4,510,236号、英国特許1380795号、ベルギー特許 841910号などに開示されている。

【0081】本発明の熱現像画像記録材料は、硬調な画 像を得るために、好ましくは画像形成層および/または その隣接層中に超硬調化剤(造核剤とも称する)を含有 する。また、本発明は超硬調画像形成のために、前記の 超硬調化剤とともに硬調化促進剤を併用することができ る。例えば、米国特許第5,545,505号に記載のアミン化 合物、具体的にはAM-1~AM-5、同5,545,507号に記 載のヒドロキサム酸類、具体的にはHA-1~HA-11、 同5.545.507号に記載のアクリロニトリル類、具体的に はCN-1~CN-13、同5,558,983号に記載のヒドラジン 化合物、具体的にはCA-1~CA-6、特開平9-297 368号に記載のオニューム塩類、具体的にはA-1~A -42、B-1~B-27、C-1~C-14などを用いることがで きる。本発明における増感色素としてはハロゲン化銀粒 子に吸着した際、所望の波長領域でハロゲン化銀粒子を 分光増感できるもので有ればいかなるものでも良い。増 感色素としては、シアニン色素、メロシアニン色素、コ ンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロシアニ ン色素、ホロポーラーシアニン色素、スチリル色素、ヘ ミシアニン色素、オキソノール色素、ヘミオキソノール 色素等を用いることができる。

【0082】赤色光への分光増感の例としては、He-Ne

53

レーザー、赤色半導体レーザーやLEDなどのいわゆる赤 色光源に対しては、特開昭54-18726号に記載のI-1からI -38の化合物、特開平6-75322号に記載のI-1からI-35の 化合物および特開平7-287338号に記載のI-1からI-34の 化合物、特公昭55-39818号に記載の色素1から20、特開 昭62-284343号に記載のI-1からI-37の化合物および特開 平7-287338号に記載のI-1からI-34の化合物などが有利 に選択される。750~1400 n mの波長領域の半導体レー ザー光源に対しては、シアニン、メロシアニン、スチリ ル、ヘミシアニン、オキソノール、ヘミオキソノールお よびキサンテン色素を含む種々の既知の色素により、ス ペクトル的に有利に増感させることができる。有用なシ アニン色素は、例えば、チアゾリン核、オキサゾリン 核、ピロリン核、ピリジン核、オキサゾール核、チアゾ ール核、セレナゾール核およびイミダゾール核などの塩 基性核を有するシアニン色素である。有用なメロシアニ ン染料で好ましいものは、上記の塩基性核に加えて、チ オヒダントイン核、ローダニン核、オキサゾリジンジオ ン核、チアゾリンジオン核、バルビツール酸核、チアゾ リノン核、マロノニトリル核およびピラゾロン核などの 酸性核も含む。上記のシアニンおよびメロシアニン色素 において、イミノ基またはカルボキシル基を有するもの が特に効果的である。例えば、米国特許3,761,279号、 同3,719,495号、同3,877,943号、英国特許1,466,201 号、同1,469,117号、同1,422,057号、特公平3-10391 号、同6-52387号、特開平5-341432号、同6-194781号、 同6-301141号に記載されたような既知の色素から適当に 選択してよい。

【0083】また、J-bandを形成する色素として米国特 許5,510,236号、同3,871,887号の実施例5記載の色素、 特開平2-96131号、特開昭59-48753号が開示されてお り、本発明に好ましく用いることができる。本発明にお けるハロゲン化銀乳剤または/および有機銀塩は、カブ リ防止剤、安定剤および安定剤前駆体によって、付加的 なカブリの生成に対して更に保護され、在庫貯蔵中にお ける感度の低下に対して安定化することができる。単独 または組合せて使用することができる適当なカブリ防止 剤、安定剤および安定剤前駆体は、米国特許第2,131,03 8号および同第2,694,716号に記載のチアゾニウム塩、米 国特許第2,886,437号および同第2,444,605号に記載のア ザインデン、米国特許第2,728,663号に記載の水銀塩、 米国特許第3,287,135号に記載のウラゾール、米国特許 第3.235.652号に記載のスルホカテコール、英国特許第6 23.448号に記載のオキシム、ニトロン、ニトロインダゾ ール、米国特許第2,839,405号に記載の多価金属塩、米 国特許第3,220,839号に記載のチウロニウム塩、ならび に米国特許第2,566,263号および同第2,597,915号に記載 のパラジウム、白金および金塩、米国特許第4,108,665 号および同第4.442.202号に記載のハロゲン置換有機化 合物、米国特許第4,128,557号および同第4,137,079号、

第4,138,365号および同第4,459,350号に記載のトリアジ ンならびに米国特許第4,411,985号に記載のリン化合物 などがある。

【0084】本発明で用いるカブリ防止剤は、溶液、粉 末、固体微粒子分散物などいかなる方法で添加してもよ い。固体微粒子分散は公知の微細化手段(例えば、ボー ルミル、振動ボールミル、サンドミル、コロイドミル、 ジェットミル、ローラーミルなど)で行われる。また、 固体微粒子分散する際に分散助剤を用いてもよい。本発 明の熱現像画像記録材料は高感度化やカブリ防止を目的 として安息香酸類を含有しても良い。本発明の熱現像画 像記録材料には現像を抑制あるいは促進させ現像を制御 するため、分光増感効率を向上させるため、現像前後の 保存性を向上させるためなどにメルカプト化合物、ジス ルフィド化合物、チオン化合物を含有させることができ る。本発明における熱現像画像記録材料は、支持体の一 方の側に少なくとも1層のハロゲン化銀乳剤を含む感光 性層のような画像形成層を有し、他方の側にバック層 (バッキング層)を有する、いわゆる片面画像記録材料 であることが好ましい。本発明においてバック層は、所 望の波長範囲での最大吸収が0.3以上2以下であることが 好ましく、さらに好ましくは0.5以上2以下の吸収であ り、かつ処理後の可視領域においての吸収が0.001以上 0.5未満であることが好ましく、さらに好ましくは0.001 以上0.3未満の光学濃度を有する層であることが好まし い。また、バック層に用いるハレーション防止染料の例 としては前述のアンチハレーション層と同じである。米 国特許第4.460.681号および同第4.374,921号に示される ような裏面抵抗性加熱層(backside resistive heating laver)を感光性熱現像写真画像系に使用することもでき る。本発明の熱現像画像記録材料における画像形成層、 保護層、バック層など各層には硬膜剤を用いても良い。 硬膜剤の例としては、米国特許4,281,060号、特開平6-2 08193号などに記載されているポリイソシアネート類、 米国特許4.791,042号などに記載されているエポキシ化 合物類、特開昭62-89048号などに記載されているビニル スルホン系化合物類などが用いられる。

【0085】本発明において、像様露光に用いられる露 光装置は露光時間が10⁻⁷ 秒未満の露光が可能な装置で あればいずれでもよいが、一般的にはLaser Diode(L D) Light Emitting Diode (LED) を光源に使用 した露光装置が好ましく用いられる。特に、LDは高出 力、高解像度の点でより好ましい。これらの光源は目的 波長範囲の電磁波スペクトルの光を発生することができ るものであればいずれでもよい。例えば L D であれば、 色素レーザー、ガスレーザー、固体レーザー、半導体レ ーザーなどを用いることができる。露光は光源の光ビー ムをオーバーラップさせて露光し、オーバーラップとは 副走査ピッチ幅がビーム径より小さいことをいう。オー 50 バーラップとは例えば、ビーム径をビーム強度の半値幅 (FWHM)で表わしたときFWHM/副走査ピッチ幅 (オーバーラップ係数)で定量的に表現することができる。本発明ではこのオーバラップ係数が0.2以上であることが好ましい。本発明に使用する露光装置の光源の走査方式は特に限定はなく、円筒外面走査方式、円筒内面走査方式、平面走査方式などを用いることができる。また、光源のチャンネルは単チャンネルでもマルチチャンネルでもよいが、円筒外面方式の場合にはマルチチャンネルが好ましく用いられる。

55

【0086】本発明の熱現像画像記録材料は露光時のへ イズが低く、干渉縞が発生しやすい傾向にある。この干 渉縞発生防止技術としては、特開平5-113548号などに開 示されているレーザー光を感光材料に対して斜めに入光 させる技術や、国際公開W〇95/31754号などに開示され ているマルチモードレーザーを利用する方法が知られて おり、これらの技術を用いることが好ましい。画像形成 方法の加熱現像工程はいかなる方法で現像されても良い が、通常イメージワイズに露光した感光材料を昇温して 現像される。用いられる熱現像機の好ましい態様として は、熱現像感光材料をヒートローラーやヒートドラムな どの熱源に接触させるタイプとして特公平5-56499号、 特許公報第684453号、特開平9-292695号、特開平9-2973 85号および国際公開W 095/30934号に記載の熱現像機、 非接触型のタイプとして特開平7-13294号、国際公開W 097/28489号、同97/28488号および同97/28487号に記載 の熱現像機がある。特に好ましい態様としては非接触型 の熱現像機である。好ましい現像温度としては80~250 ℃であり、さらに好ましくは100~140℃である。現像時 間としては1~180秒が好ましく、5~90秒がさらに好ま しい。本発明の熱現像感光材料の熱現像時の寸法変化に よる処理ムラを防止する方法として、80℃以上115℃未 満の温度で画像が出ないようにして3秒以上加熱した 後、110℃以上140℃以下で熱現像して画像形成させる方 法(いわゆる多段階加熱方法)が有効である。

【0087】本発明の熱現像画像記録材料の熱現像処理 に用いられる熱現像機の一構成例を図1に示す。図1は 熱現像機の側面図を示したものである。図-1の熱現像 機は熱現像感光材料10を平面状に矯正及び予備加熱し ながら加熱部に搬入する搬入ローラー対11 (下部ロー ラーがヒートローラー)と熱現像後の熱現像後の熱現像 感光材料10を平面状に矯正しながら加熱部から搬出す る搬出ローラー対12を有する。熱現像感光材料10は 搬入ローラー対11から搬出ローラー対12へと搬送さ れる間に熱現像される。この熱現像中の熱現像感光材料 10を搬送する搬送手段は画像形成層を有する面が接触 する側に複数のローラー13が設置され、その反対側の バック面が接触する側には不織布(たとえばポリフェニ レンサルファイトやテフロンから成る)等が貼り合わさ れた平滑面14が設置される。熱現像感光材料10は画 像形成層を有する面に接触する複数のローラー13の駆 動により、バック面は平滑面14の上を滑って搬送される。加熱手段はローラー13の上部及び平滑面14の下部に熱現像感光材料10の両面から加熱されるように加熱ヒーター15が設置される。この場合の加熱手段としては板状ヒーター等が挙げられる。ローラー13と平滑面14とのクリアランスは平滑面の部材により異なるが、熱現像感光材料10が搬送できるクリアランスに適宜調整される。好ましくは0~1mmである。

【0088】ローラー13の表面の材質及び平滑面14 の部材は、高温耐久性があり、熱現像感光材料10の搬 送に支障がなければ何でも良いが、ローラー表面の材質 はシリコンゴム、平滑面の部材は芳香族ポリアミドまた はテフロン(PTFE)製の不織布が好ましい。加熱手 段としては複数のヒーターを用い、それぞれ加熱温度を 自由に設定することが好ましい。なお、熱現像処理部の 上流の予備加熱部は、熱現像温度よりも低く(例えば 1 0~20℃程度程度低く)、熱現像感光材料中の水分量 を蒸発させるのに十分な温度および時間に設定すること が望ましく、熱現像感光材料10の支持体のガラス転移 温度(Tg)よりも高い温度で、現像ムラが出ないよう に設定することが好ましい。また、熱現像処理部の下流 にはガイド板16が設置され、さらに、徐冷部が設置さ れる。ガイド板は熱伝導率の低い素材が好ましく、冷却 は徐々に行うのが好ましい。以上、図示例に従って説明 したが、これに限らず、例えば特開平7-13294号に記載 のものなど、本発明に用いられる熱現像機は種々の構成 のものであってもよい。また、本発明において好ましく 用いられる多段加熱方法の場合は、上述のような装置に おいて、加熱温度の異なる熱源を2個以上設置し、連続 30 的に異なる温度で加熱するようにすればよい。

[0089]

【実施例】以下に実施例を記載して本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、操作等は、本発明の精神から逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例に制限されるものではない。

<実施例1>

1. ハロゲン化銀乳剤の調製

(1-1) 乳剤A

水700m1にアルカリ処理ゼラチン(カルシウム含有量として2700ppm以下)11gおよび臭化カリウム30mg、ベンゼンチオスルホン酸ナトリウム10mgを溶解して温度40℃にてpHを5.0に合わせた後、硝酸銀18.6gを含む水溶液159m 1と臭化カリウムを1モル/リットル(NH4)2RhCls(H2O)を5×10⁶ モル/リットル及びK3IrClsを2×10⁵ モル/リットルで含む水溶液をpAg7.7に保ちながらコントロールダブルジェット法で6分30秒間かけて添加した。ついで、硝酸銀55.5gを含む水溶液476m1と臭化カリウムを1モル/リットル及びK3IrClsを2×10⁵ モル/リットルで含むハロゲン塩水溶液をpAg7.7に保

ちながらコントロールダブルジェット法で28分30秒間かけて添加した。その後pHを下げて凝集沈降させて脱塩処理をし、化合物 A を0.17g、平均分子量 1 万 5 千の低分子量ゼラチン(カルシウム含有量として20ppm以下)51.1g加え、pH5.9、pAg8.0に調製した。得られた粒子は平均粒子サイズ0.08 μm、投影面積変動係数9%、(100)面比率90%の立方体粒子であった。こうして得たハロゲン化銀粒子を60℃に昇温して銀1モル当たりベンゼンチオスルホン酸ナトリウム76 μモルを添加し、3分後にトリエ * **増**8色異A

* チルチオ尿素71 μ モルを添加して、100分熟成し、 4 ー ヒドロキシー6 ーメチルー1 , 3 , 3 a , 7 ーテトラザインデンを 5×10^{-4} モル加えた後、40 ℃に降温させた。その後、40 ℃に温度を保ち、ハロゲン化銀1モルに対して12.8× 10^{-4} モルの下記増感色素 A 、 6.4×10^{-3} モルの化合物 B を撹拌しながら添加し、20 分後に30 ℃に急冷してハロゲン化銀乳剤 A の調製を終了した。

[0090] 【化16】

50

【0091】(1-2)有機酸銀分散物の調製

<有機酸銀A>ヘンケル社製ベヘン酸(製品名Eden orC22-85R)87.6g、蒸留水423m1、5N-NaOH水溶液49. 2ml、tertーブチルアルコール120mlを混合し、75℃にて 1時間攪拌し反応させ、ベヘン酸ナトリウム溶液を得 た。別に、硝酸銀40.4gの水溶液206.2mlを用意し、10℃ にて保温した。635mlの蒸留水と30mlのtert-ブチルアル コールを入れた反応容器を30℃に保温し、攪拌しながら 先のベヘン酸ナトリウム溶液の全量と硝酸銀水溶液の全 量を流量一定でそれぞれ62分10秒と60分かけて添加し た。この時、硝酸銀水溶液添加開始後7分20秒間は硝酸 銀水溶液のみが添加されるようにし、そのあとベヘン酸 ナトリウム溶液を添加開始し、硝酸銀水溶液添加終了後 9分30秒間はベヘン酸ナトリウム溶液のみが添加される ようにした。このとき、反応容器内の温度は30℃とし、 液温度が上がらないようにコントロールした。また、ベ ヘン酸ナトリウム溶液の添加系の配管は、スチームトレ ースにより保温し、添加ノズル先端の出口の液温度が75 ℃になるようにスチーム量をコントロールした。また、 硝酸銀水溶液の添加系の配管は、2重管の外側に冷水を 循環させることにより保温した。ベヘン酸ナトリウム溶 液の添加位置と硝酸銀水溶液の添加位置は攪拌軸を中心 として対称的な配置とし、また反応液に接触しないよう な高さに調節した。ベヘン酸ナトリウム溶液を添加終了 後、そのままの温度で20分間攪拌放置し、25℃に降温し た。その後、吸引濾過で固形分を濾別し、固形分を濾水 の伝導度が30μS/cmになるまで水洗した。こうして得ら

れた固形分は、乾燥させないでウエットケーキとして保管した。得られたベヘン酸銀の粒子の形態を電子顕微鏡撮影により評価したところ、平均投影面積径 $0.52\,\mu$ m、平均粒子厚み $0.14\,\mu$ m、平均球相当径の変動係数15%の鱗片状の結晶であった。

【0092】つぎに、以下の方法でベヘン酸銀の分散物 を作成した。乾燥固形分100g相当のウエットケーキに 対し、ポリビニルアルコール(商品名: PVA-217, 平均重 合度:約1700)7.4gおよび水を添加し、全体量を385g としてからホモミキサーにて予備分散した。次に予備分 散済みの原液を分散機(商品名:マイクロフルイダイザ ーM-110S-EH、マイクロフルイデックス・イン ターナショナル・コーポレーション製、G10Zインタ ラクションチャンバー使用)の圧力を1750kg/cm⁶に 調節して、三回処理し、ベヘン酸銀分散物を得た。冷却 操作は蛇管式熱交換器をインタラクションチャンバーの 前後に各々装着し、冷媒の温度を調節することで所望の 分散温度に設定した。こうして得たベヘン酸銀分散物に 含まれるベヘン酸銀粒子は体積加重平均直径0.52 µ m、、変動係数15%の粒子であった。粒子サイズの測定は、 Malvern Instruments Ltd. 製MasterSizerXにて行った。 また電子顕微鏡撮影により評価すると、長辺と短辺の比 が1.5、粒子厚み0.14μm、平均アスペクト比(粒子の投 影面積の円相当径と粒子厚みの比)が5.1であった。 【0093】(1-3)1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジ

【0093】(1-3)1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン: 還元剤固体微粒子分散物の調製

*製

59

1.1-ビス(2-ヒドロキシ-3.5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルへキサン25gに対してクラレ(株)製MPポリ マーのMP-203の20%水溶液を25g、日信化学(株)製サフ ィノール104Eを0.1g、メタノール2gと水48ml添加してよ く撹拌して、スラリーとして3時間放置した。その後、1 nnのジルコニアビーズを360g用意してスラリーと一緒に ベッセルに入れ、分散機(1/4Gサンドグラインダーミ ル:アイメックス(株)製) にて3時間分散し還元剤固体 微粒子分散物を調製した。粒子径は、粒子の80重量%が 0.3μπ以上1.0μπ以下であった。

【0094】(1-4)ポリハロゲン化合物の固体微粒 子分散物の調製

ポリハロゲン化合物-Aの30gに対してクラレ(株)製 MPポリマーのMP-203を4g、化合物CO.25gと、水66gを 添加し良く撹拌し、その後0.5mmのジルコニアシリケー トビーズを200g用意してスラリーと一緒にベッセルに入 れ、分散機(1/16Gサンドグラインダーミル:アイメッ クス(株)製)にて5時間分散し、固体微粒子分散物を 調製した。粒子径は、粒子の80重量%が0.3μm以上1.0μ m以下であった。ポリハロゲン化合物 – Bについてもポ リハロゲン化合物-Aと同様に固体微粒子分散物を調製 し、同様な粒子径となった。

【0095】(1-5)造核剤の固体微粒子分散物の調*

・バインダー; ラックスター3307 B

固形分として 397g (大日本インキ化学工業(株)製;SBRラテックスでガラス転移温度17℃)

・1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)-3,5,5-トリメチルヘキサン

造核剤(化合物 A A) 10gに対して、ポリビニルアルコ ール(クラレ製PVA-217)2.5g、水87.5gを添加し良く攪 拌してスラリーとして3時間放置した。その後、0.5mmの ジルコニアビーズを240g用意してスラリーと一緒にベッ セルに入れ、分散機(1/4Gサンドグラインダーミル:ア イメックス(株)製)にて10時間分散し、固体微粒子分

散物を調製した。粒子径は、粒子の80重量%が0.1 µ m以 上1.0 µ m以下で、平均粒径0.5 µ mであった。

【0096】(1-6)化合物Zの固体微粒子分散物の 10

化合物Zの30gに対して、クラレ(株)製MPポリマー のMP-203を3gと水87ml添加してよく攪拌して、スラリー として3時間放置した。その後、上記還元剤固体微粒子 分散物の調製と同様にして、化合物Zの固体微粒子分散 物を調製した。粒子径は、粒子の80wt%が0.3 µ m以上1. 0μm以下であった。

【0097】(1-7)乳剤層塗布液の調製 上記で作成した有機酸銀微結晶分散物の銀1モルに対し て、以下のバインダー、素材、およびハロゲン化銀乳剤 Aを添加して、水を加えて、乳剤層塗布液とした。粘度 は20-70cp (25°C) であり、pHは7. 4であ った。

	固形分として	149g
・ポリハロゲン化合物-A	固形分として	34.8g
・ポリハロゲン化合物-B	固形分として	9. 0g
・エチルチオスルホン酸ナトリウム		0.30g
・ベンゾトリアゾール		1.04g
・ポリビニルアルコール (クラレ(株)製PVA-2	235)	10.8g
・6-iso-プロピルフタラジン		15. 0g
・オルトりん酸二水素ナトリウム・2水和物		0.37g
・化合物 Z	固形分として	9. 7g
・造核剤(化合物 A A)		5.0g
・染料 A 783nmの光学濃度が0.3になる	塗布量 (目安として	C0. 37g)
・ハロゲン化銀乳剤A	Ag量としてO.	06モル

[0098]

【化17】

【0099】2. 乳剤面下層保護層塗布液の調製メチルメタクリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸=58.9/8.6/25.4/5.1/2(wt%)のポリマーラテックス溶液(共重合体でガラス転移温度57℃、固形分濃度として21.5%、造膜助剤として化合物Dをラテックスの固形分に対して15wt%含有)956gにH20を加え、化合物E-1 0.81、化合物E-2 0.81g、化合物S 1.62g、マット剤(ポリスチレン粒子、平均粒径7μm)1.98gおよびポリビニルアルコール(クラレ(株)製、PVA-235)23.6gを加え、さらにH20を加えて、塗布液を調製とした。粘度は20-70cp(25℃)であり、pHは5.4であった。

【0100】3.乳剤面上層保護層塗布液の調製 先ず、以下の方法により滑り剤分散粒子を作成した。化 40 合物 L B - 7を(60g)と化合物WA - 2(40g)を2 リットルのステンレス分散機に添加し、100℃に加温し て混合して均一にして粘性のある混合物を得た。この溶 融混合液に95℃の熱水800gを加え、高速でホモジナイ ザー(10000回転、10分)で分散した。 挽拌を継続しつ つ分散機を冷却して内温を徐々に低下した。このように して得られた滑り剤の分散粒子は光回折法でその平均粒 子径を評価したところ、0.09μmであり優れた分散物で あった。次いで、メチルメタクリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート/2-ヒドロキシエチルメタ 50 クリレート/アクリル酸=58.9/8.6/25.4/5.1/2(wt

%)のポリマーラテックス溶液(共重合体でガラス転移温度54℃、固形分濃度として21.5%、造膜助剤として化合物Dをラテックスの固形分に対して15wt%含有)630gに16.0を加え、上記で作製した滑り剤分散粒子10wt%溶液を添加量相当量、化合物E-1、 0.36g、化合物E-2 0.36g、化合物F 7.95g、化合物S 0、72g、マット剤(ポリスチレン粒子、平均粒径7μπ)*

63

* 1.18gおよびポリビニルアルコール(クラレ(株)製, PVA -235)8.30gを加え、さらに1600を加えて、塗布液を調製とした。粘度は 20-70 c p(25 \mathbb{C})であり、 p H は 2.9 であった。

【0101】 【化18】

化合物D CH₃ OH CH₃ O CH₃ CHCH-CCH₂OCCH CH₃ CH₃

化合物E-1 C₈F₁₇SO₂NCH₂COOK C₃H₇

化合物E-2 C₈F₁₇SO₂N+CH₂CH₂O)₄+CH₂)₄SO₃Na C₃H₇

化合物F CH₃ COOH

化合物S NH NH NH

【0 1 0 2】 <u>4. バック/下塗り層のついたPET支持体</u> の作製

(4-1) 支持体

テレフタル酸とエチレングリコールを用い、常法に従い、IV(固有粘度)=0.66(フェノール/テトラクロルエタン=6/4(重量比)中25 $\mathbb C$ で測定)のPETを得た。これをペレット化した後、 $130\mathbb C$ で4時間乾燥した後、 $300\mathbb C$ で溶融後 $\mathbb T$ 型ダイから押し出した後急冷し、熱固定後の膜厚が 120μ mになるような厚みの未延伸フ $\mathbb X$

※イルムを作成した。これを周速の異なるロールを用い、3.3倍に縦延伸、ついでテンターで4.5倍に横延伸を実施した。このときの温度はそれぞれ、110℃、130℃であった。この後、240℃で20秒間熱固定後これと同じ温度で横方向に4%緩和した。この後、テンターのチャック部をスリットした後、両端にナール加工を行い、4.8kg/cm²で巻きとった。このようにして、幅2.4m、長さ3500m、厚み120μmのロールを得た。

[0103]

(4-2)下塗り層(a)

・ポリマーラテックス- (1) (コア部90重量%、シェル部10重量%のコアシェルタイプのラテックスで、コア部:塩化ビニリデン/メチルアクリレート/メチルメタクリレート/アクリロニトリル/アクリル酸=93/3/3/0.9/0.1(重量%)、シェル部:塩化ビニリデン/メチルアクリレート/メチルメタクリレート/アクリロニトリル/アクリル酸=88/3/3/3/3(重量%)から成る重量平均分子量38000のポリマーラテックス)

固形分量として 3.0g/m^c

・2.4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-s-トリアジン

23mg/m^{*}

・マット剤(ポリスチレン、平均粒子径2.4 µm)

1.5mg/m^{*}

[0104]

(4-3)下塗り層(b)

・脱イオン処理ゼラチン

(Ca²⁺ 含量0.6ppm、ゼリー強度230g

50mg/m[°]

66

[0105]

[0106]

(4-4) 導電層

・ジュリマーET-410 (日本純薬 (株) 製)

96mg/m²

・アルカリ処理ゼラチン(分子量約10000、Ca* 含量30ppm)

42mg/m²

・脱イオン処理ゼラチン (Ca²⁺ 含量0.6ppm)

8mg/m[°]

・化合物-A

0. 2mg/m

・ポリオキシエチレンフェニルエーテル

10mg/m[°]

・スミテックスレジンM-3

(水溶性メラミン化合物、住友化学工業(株)製)

18mg/m

·染料A

783nmの光学濃度が1.2になる塗布量

・SnO2/Sb(9/1重量比、針状微粒子、長軸/短軸=20~30、

石原産業 (株) 製)

160mg/m²

・マット剤(ポリメチルメタクリレート、平均粒子径5μm)

7mg/m[°]

(4-5) バック保護層

・ポリマーラテックスー(2)

(メチルメタクリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート/ 2-ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸

=59/9/26/5/1(重量%の共重合体)) 固形分量として 1000mg/m²

ポリスチレンスルホン酸塩(分子量1000~5000)

2.6mg/m

セチル硫酸ナトリウム

10mg/m

・セロゾール524(カルナウバワックス、中京油脂(株))

15mg/m[°]

・スミテックスレジンM-3

(水溶性メラミン化合物、住友化学工業(株)製)

218mg/m²

【0107】(4-6)バック/下塗り層のついたPE

T支持体の作製

順次塗布し、それぞれ180℃、4分間乾燥した。つい で、下塗り層(a)と下塗り層(b)を塗布した上の一方の側 の面に導電層と保護層を順次塗布し、それぞれ180℃、4 分間乾燥して、バック/下塗り層のついたPET支持体を 作製した。下塗り層(a)の乾燥厚みは2.0μmであっ た。

* (5-1) 熱処理

作製したバック/下塗り層のついたPET支持体を160℃設 支持体(ベース)の両面に下塗り層(a)と下塗り層(b)を 30 定した全長200m熱処理ゾーンに入れ、張力3kg/cm⁴、搬 送速度20m/分で搬送した。

(5-2)後熱処理

上記熱処理に引き続き、40℃のゾーンに15秒間通して後 熱処理を行い、巻き取った。この時の巻き取り張力は10 kg/cm²であった。

[0109]

【化19】

【0108】5. 搬送熱処理

化合物A

【0110】6. 熱現像感光材料の作製

前記下塗り層(a)と下塗り層(b)を塗布した側のPET支持 体の下塗り層の上に前記の乳剤層塗布液を塗布銀量1.7g 50 量が1.31g/m²になるように乳剤塗布液と共に同時重層塗

/㎡になるように塗布した。さらにその上に、前記乳剤 面下層保護層塗布液をポリマーラテックスの固形分塗布

布した。その後でその上に前記乳剤面上層保護層塗布液をポリマーラテックスの固形分塗布量が $3.02g/m^2$ になるように塗布し、熱現像感光材料を作製した。得られた熱現像感光材料の画像形成側の膜面 p H は4.9、ベック平滑度が660秒であり、反対側の膜面 p H は5.9、ベック平滑度は560であった。

67

【0111】7. 熱現像

(7-1) 露光処理

得られた熱現像感光材料を、ビーム径(ビーム強度の1/2の F W H M)12.56 μ m、レーザー出力50 mW、出力波長 10 783 nmの半導体レーザーを搭載した単チャンネル円筒内面方式のレーザー露光装置を使用し、ミラーの回転数を変化させることにより露光時間を、出力値を変えることにより露光量を調整し、 $2\times10^{\circ}$ 秒で露光した。この時のオーバーラップ係数0.449にした。

(7-2) 熱現像処理

露光済みの熱現像感光材料を図1の熱現像機を用いて、 熱現像処理部のローラー表面材質はシリコンゴム、平滑 面はテフロン不織布にして予備加熱部90~100℃で5秒、 熱現像処理部120℃で20秒間熱現像処理を行った。な お、幅方向の温度精度は±1℃であった。

【0112】8. 評価

(8-1) 熱現像ムラの評価

図1に示す熱現像機を用いて、現像温度120℃、現像時間30秒の現像条件で試料(サイズ60cm×75cm)を熱現像処理し、処理中での試料の皺(シワ)の発生の有無を目視で観察した。なお、図1のドラム式熱現像機は、ランプの配光を最適化し、幅方向の温度精度を±1℃で行った。また、矯正ガイド板7付近において熱現像画像記録材料の温度が90℃以下にならないように雰囲 30気温度を調整した。評価は以下に分類した。

A:熱現像ムラは認められない。

B:熱現像ムラが少し認められる。

C:熱現像ムラが相当認められる。

【0113】(8-2)傷つき

図1に示す熱現像機を用いて、現像温度120℃、現像時間30秒の現像条件で試料(サイズ60cm×75cm)を熱現像処理し、処理後の画像面側の傷の発生レベルを目視で観察した。なお、図1のドラム式熱現像機は、ランプの配光を最適化し、幅方向の温度精度を±1℃で行った。また、矯正ガイド板7付近において熱現像画像記録材料の温度が90℃以下にならないように雰囲気温度を調整した。評価は以下に分類した。

A: 熱現像後の傷つきがほとんど認められず、プリント上に実害ない。

B: 熱現像後の傷つきが少し認められ、プリント上に写る。

C: 熱現像後の傷つきが相当認められ、プリント上で修 復不可能な実害を発生する。

【0114】(8-3)接着跡

得られた生試料を、25 %、70 %RH条件下で2 時間調湿し、バック面と乳剤面を重ねあわせ、荷重100 g / c m^2 で3 日放置経時させ、乳剤面の接着程度を目視で観察した。

A:接着跡は認められない。

B:接着跡が少し認められる。

C:接着跡が相当認められる。

【0115】(8-4)面状

得られた生試料50m²の画像面の面状を目視で観察し た。ハジキおよびブツの発生レベルと頻度で以下の評価 を実施した。

A:ハジキ、ブツは認められない。

B:ハジキ、ブツが少し認められる。

C:ハジキ、ブツが相当認められる。

【0116】(8-5)液経時後の面状

画像側の保護層の塗布液を25℃で回転数100 r p m にて攪拌しつつ、48時間放置した。この液を用いて、予め作成された乳剤層と乳剤面下層保護層の上に、塗布した。得られた生試料50 m²の画像面の面状を目視で観察した。ハジキおよびブツの発生レベルと頻度で以下の評価を実施した。

A:ハジキ、ブツは認められない。

B:ハジキ、ブツが少し認められる。

C:ハジキ、ブツが相当認められる。

【0117】(8-6)ゴミ付き評価

得られた試料を全露光状態で、120 ° 、25 秒で熱処理し黒化サンプルとした。このサンプルを25 ° 、10 %RH条件下で2時間調湿し、バック面と乳剤面を重ねあわせ、荷重1 kg/c m^2 で10 回こすった。この乳剤面に粉砕したポリスチレン片をばらまき、その付着程度を目視で観察した。

A:ポリスチレン片の付着は認められない。

B:ポリスチレン片の付着が少し認められる。

C:ポリスチレン片の付着が相当認められる。

【0118】(8-7)導電性

得られた生試料を、25℃、10%RH条件下で2時間調湿し、側面に銀ペイントを塗布して、試料の電気抵抗

(Ω)を測定した。

(8-8) 熱現像処理に伴う寸法変化率の測定法

全面を曝光した処理前の試料(サイズ $5\,cm \times 2\,5\,cm$)に $2\,0\,0\,mm$ の間隔を置いて、直径 $8\,mm$ の穴を $2\,d$ 個開け、 $1\,1\,0\,0\,0\,mm$ 精度のピンゲージを用いて、 $2\,d$ の穴の間隔を正確に測定した。このときの寸法をX(単位m)とする。ついで、図 $1\,0\,mm$ の現像条件で熱現像処理した後、 $1\,2\,0\,mm$ 後とピンゲージにて測定した。このときの寸法をY(単位m)とする

寸法変化率 (%) = $[(Y-X)/200] \times 100$ の値で評価した。ベースの横方向についての評価値であ

50 る。

【0119】(8-9)評価結果

得られた試料01~16についての特性評価をした。表 1から明らかなように、本発明の試料04~14は、動 摩擦係数も小さくまた、熱現像ムラ、傷つき、接着跡お よび面状の全てを満足するものであった。熱現像に伴う 寸法変化率も小さく、75%RHでの経時による寸法変化 率も小さく、かつゴミ付きのない優れた熱現像画像材料 であった。さらに導電性は、1008乗台(Ω)の抵抗 で優れたものであった。また、寸度安定性も優れたもの 較資料01は、動摩擦係数が極端に大きく面状は良好な ものの、熱現像ムラ、傷つき、接着跡の点で大きく劣る ものであった。また、一般式(1)の化合物のみからな る比較試料02は滑り剤分散粒子の粒径が大きく、塗布 液の経時のない場合の感材では熱現像ムラ、傷つき、接

69

着跡および面状も良好であったが、乳剤面上層保護層の 塗布液を経時すると、面状が大幅に悪化するものであっ た。更にまた、一般式(2)の化合物のみからなる比較 試料03は、面状はよいものの熱現像ムラ、傷つきおよ び接着跡が悪く実用上で問題であった。また、本発明以 外の比較滑り剤を用いて作成された比較試料14および1 5は粒径が大きく、動摩擦係数の低下は若干見られるも のの熱現像ムラ、傷つき、接着跡さらには面状のすべて を満足することはできなかった。さらに本発明の熱現像 であった。一方、本発明で用いる滑り剤を含有しない比 10 感光材料は写真性の欠陥がなく、画像として優れたもの であった。以上から、本発明の熱現像画像記録材料は、 比較用の記録材料と比較して優れた記録材料であること が明白である。

[0120]

【表1】

	化合物 (1		化合物	(2)	1	新職技	数相係	値)			液経時
多女は	四 四	含有量	2番素	含有量	有品	金数	# 20 A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	E MO	按看路	阿茨	後間のは
		mg/m;	K H	ш 3/ш							≨
試料01(比較)	なしな	0	なし	0		0.59	ပ	ပ	ပ	∢	4
試料 02 (比較)	LB-7	25	なし	0	0.21	0.11	A	4	⋖	∢	ပ
1試料03(比較)	つな	0	WA-2	2.5	0.05	0.19	Ф	ပ	æ	4	4
試料 04 (本発明)	LB-7	24.9	WA-2	0.1	0.21	0.12	4	V	<	4	В
試料 05 (本発明)	L B – 7	20	WA-2	5	0.14	0.11	4	∢	⋖	∢	∢
試料06(本発明)	LB-7	15	WA-2	1 0	0.10	0.11	4	4	∢	∢	∢
試料 07 (本発明)	LB-5	15	WA-2	10	0.09	0.10	4	V	V	4	A
試料 08 (本発明)	LB-15	15	WA-2	1 0	0.08	0.10	4	4	<	4	4
試料 09 (本発明)	LB-26	15	WA-2	10	0.09	0.11	4	∢	V	4	4
試料 10 (本発明)	LB-4	1.5	WA-2	1 0	0.07	0.10	∢	∢	∢	∢	∢
試料11 (本発明)	LB-7	1.5	WA-4	1 0	0.08	60.0	٧	V	∢	٧	A
試料12 (本発明)	L B – 7	15	M A - 8	1 0	0.09	0.10	٧	V	4	∢	¥
試料13 (本発明)	LB-7	1.5	WA-10	1 0	0.09	0.11	4	4	4	٨	∢
試料14 (本発明)	カルナウバワックス	1 5	7 – 2 M	1 0	0.07	0.10	V	V	A	4	∢
試料15 (比較)	ボリジメチルショキサン	1.5	WA-2	1 0	0.20	0.17	٧	ပ	ပ	8	3
試料16(比較)	流動パラフィン	1.5	WA-2	1 0	0.25	0.25	ပ	ပ	80	В	၁

【0121】<実施例2>実施例1の本発明の試料06 において画像層側の最外層に添加した滑り剤分散粒子を 分散する際の分散時間を少なくした(標準10分を3分 にて終了)以外は、実施例1と全く同様にして試料26 50 価において実害はないが面状がA~Bランクの間となり

を得た。これらの試料について、実施例1と同様に全く 同様に評価を行った。その結果、粒径が0.36μmと 大きくなり動摩擦係数も0.26となった。その特性評 若干滑り剤分散粒子の粒径の影響が見られた。この結果から、滑り剤分散粒子の粒径は小さい方が優れることがわかる。

73

【0122】<実施例3>実施例1の本発明の試料06において画像形成層側の最外層に添加したフッ素系界面活性剤を除去する以外は、実施例1と全く同様にして試料36を得た。これらの試料について、実施例1と同様に全く同様に評価を行った。その結果、実害はないが押し出しコーターの塗布に際し、塗布スピードを150m/分に上げた時に若干最初の塗り付けが不安定であった。これに対して、本発明の好ましい態様である試料06の塗布液は高速塗布でも安定したギーサービードを形成し、塗り付けも安定したものであった。これらの結果から、フッ素系界面活性剤の添加が本発明の効果を発揮するのに優れたものであることがわかる。

【0123】<実施例4>実施例1の本発明の試料06において画像層側のバック側の導電性層の針状導電性アンチモン含有酸化錫微粉末を除去した以外は、実施例1と全く同様にして試料36を得た。試料06の導電性が 10^{82} であるのに対して、試料46の導電性は 10^{15} のであり、導電性が失活した。これらの試料について、実施例1と全く同様に評価を行った。その結果、実害はないが反射で詳細に観察した時に、面状が弱いムラを発生することがわかった。これに対して、本発明の好ましい態様である試料06の塗布液はこれらのムラは全く見られず優れた画像を得ることができた。これらの結果から、導電性層を付与することが、本発明の効果を発揮するのに優れたものであることがわかる。

【0124】<実施例5>実施例1の本発明の試料06 において支持体の下塗り層の塩化ビニリデン素材をSBR *30

*化合物に変更する以外は実施例1と全く同様にして試料56を得た。これらの試料について、実施例1と全く同様に評価を行った。その結果、塩化ビニリデン下塗り層に代わり、SBRラテックスを下塗りした比較試料55は、熱現像に伴う寸法変化率や75%RHでの経時による寸法変化率は少し悪化したけれども、実用上特に問題はなかった。以上から、塩化ビニリデン下塗り層を有する場合に、特に優れた熱現像記録材料が得られることが判明した。

10 [0125]

【発明の効果】本発明により、熱現像時のムラ、傷つき、接着跡および面状が大幅に改良された熱現像画像記録材料を提供することが可能になった。また、本発明により、熱現像後の経時に伴う寸法変化が少なく、ゴミ付きのない優れた熱現像画像記録材料を作成することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】熱現像機の一構成例を示す側面図である。 【符号の説明】

- 20 10 熱現像感光材料
 - 11 搬入ローラー対
 - 12 搬出ローラー対
 - 13 ローラー
 - 14 平滑面
 - 15 加熱ヒーター
 - 16 ガイド板
 - A 予備加熱部
 - B 熱現像処理部
 - C 徐冷部

【図1】

